# (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# A 1881 E BARBARA IN BERNAR HAND BEINE BEINE BORD FOR BER BERNE BIND EERBE HERD BIN BORREN BERN 1881 HER HER BE

### (43) 国際公開日 2004 年2 月26 日 (26.02.2004)

**PCT** 

# (10) 国際公開番号 WO 2004/016716 A1

社荏原製作所 (EBARA CORPORATION) [JP/JP]; 〒144-8510 東京都 大田区 羽田旭町11-1 Tokyo (JP).

(51) 国際特許分類7:

C10.J 3/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/010267

(22) 国際出願日:

2003 年8 月12 日 (12.08.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-236997

2002年8月15日(15.08.2002) 月

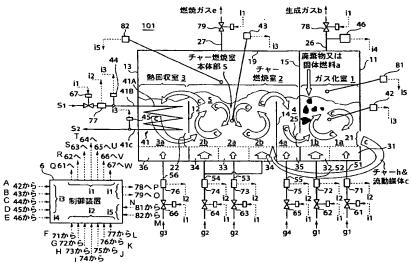
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 松岡 慶 (MAT-SUOKA,Kei) [JP/JP]; 〒144-8510 東京都 大田区 羽田 旭町11-1 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 徳留 達夫 (TOKUDOME,Tatsuo) [JP/JP]; 〒144-8510 東京都 大田区 羽田旭町11-1 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 細田 修吾 (HOSODA,Shugo) [JP/JP]; 〒144-8510 東京都 大田区 羽田旭町11-1 株式会社荏原製作所内

/続葉有/

(54) Title: GASIFICATION FURNACE

(54) 発明の名称: ガス化炉



174から <sup>-</sup>		
,	BFROM 43	MFROM 82
1GASIFICATION CHAMBER	CFROM 44	NFROM 81
2CHAR COMBUSTION CHAMBER	DFROM 45	OTO 79 PTO 78
3HEAT COLLECTING CHAMBER	EFROM 46	
5CHAR COMBUSTION CHAMBER BODY PART	FFROM 71	QTO 61
6CONTROL DEVICE	GFROM 72	RTO 62
aWASTE OR SOLID FUEL	HFROM 73	STO 63
bGENERATED GAS	1FROM 74	TTO 64
eCOMBUSTION GAS	JFROM 75	UTO 65
h & cCHAR & FLOW MEDIUM	KFROM 76	VTO 66
AFROM 42	LFROM 77	W TO 67

gasification (57) Abstract: Α (101)having increased control characteristics, comprising a gasification chamber (1) for flowing hot flow medium (c), forming a fluidized bed, and gasifying treated matter (a), a char combustion chamber (2) for flowing the flow medium (c), forming the fluidized bed, and burning char (h) generated by the gasification of the treated matter in the chamber (1) to heat the flow medium and a control device (6) for controlling the temperature of the gasification chamber or the char combustion chamber by controlling the intensity of flow in a weak flow state to control the amount of the flow medium circulating between the chambers, wherein the chambers (1) and (2) are separated from each other through partition walls (11) and (15) to prevent gas from flowing therebetween over the boundary surface of the fluidized bed, communication ports (21) and (25) allowing the chamber (1) to communicate with the chamber (2) and having upper end heights of below the

boundary surface are formed in the lower parts of the partition walls, the flow state of the flow medium (c) near the communication port of one chamber of the chambers (1) and (2) on both sides of the communication ports is set stronger than the flow state of the flow medium near the communication port of the other chamber to move the flow medium (c) from a weak flow state to a strong flow state through the communication ports.

(57) 要約: 高温流動媒体cを流動させ、流動床を形成し、被処理物aをガス化するガス化室!と、高温流動媒体 c を流動させ、流動床を形成し、室!でのガス化に伴い発生するチャーhを燃焼させ流動媒体を加熱するチャー燃焼室2を備え、室!と室2は、流動床界面上方でガス流通がないように

/続葉有/

WO 2004/016716 A1 |||

- Tokyo (JP). 豊田 誠一郎 (TOYODA, Seiichiro) [JP/JP]; 〒144-8510 東京都 大田区 羽田旭町11-1 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 宮川 貞二, 外(MIYAGAWA, Teiji et al.); 〒 160-0005 東京都 新宿区 愛住町19番地 富士 t\* 1/6階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

### 一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

仕切壁11、15により仕切られ、仕切壁下部には室1と室2を連通する連通口21、25であり、連通口上端の高さは界面以下である連通口が形成され、連通口を挟む室1と室2のうち一方の室の連通口近傍における流動媒体cの流動状態が、他方の室の連通口近傍における流動媒体の流動状態より強く、連通口を通じ、弱流動状態から強流動状態の方に流動媒体cが移動するように構成され、弱流動状態の流動強弱を調節し、室と室間で流通する流動媒体量を制御し、ガス化室又はチャー燃焼室の温度を制御する制御装置6を備えるガス化炉101とし、制御特性を向上させたガス化炉とすることができる。

# 明 # **AP20 Rec'** 4 FGT/770 01 FEB 2006

ガス化炉

### 5 技術分野

本発明は、各種廃棄物や固体燃料等を熱分解してガス化するガス化炉に関する。

### 背景技術

15

20

25

各種の廃棄物や固体燃料を熱分解してガス化する流動床式のガス化炉において、 10 反応に関わる諸因子のうち、例えばガス化炉の流動層の層温を変えるためには、 ガス化炉内に供給する酸素の流量、または酸素を含むガス(例えば空気など)の 流量を変えることが行われていた。

しかし、酸素の供給を増やした場合は、生成ガスに含まれる燃焼ガスの量が増加し、生成ガスの発熱量が低下する。一方、酸素の供給を減らした場合には、チャー、タール等のガス化残渣の発生量が増大し、ガス化効率が低下する。

これに対処するため、各種廃棄物や固体燃料のガス化を行うガス化ゾーンと、ガス化により発生したチャー、タール等のガス化残渣を燃焼する燃焼ゾーンとを備え、燃焼ゾーンで発生した燃焼熱をガス化ゾーンでのガス化反応熱に利用し、さらに、ガス化ゾーン及び燃焼ゾーンのそれぞれを流動層装置とし、上記のガス化残渣及び熱の移動を流動媒体を介して行う、内部循環流動床式のガス化炉を採用する方法がある。

内部循環流動床式のガス化炉では、ガス化ゾーンから燃焼ゾーンへのガス化残 渣の移動、燃焼ゾーンからガス化ゾーンへの熱の移動を円滑に行うため、流動媒 体粒子の移動量を精緻に制御することが重要である。しかし、この従来の内部循 環流動床式のガス化炉では、流動媒体粒子の移動量を制御するために、流動層装 置に供給する流動化ガスの量を大幅に変化させる必要があり、装置の操作条件が 大きく変化してしまうという問題があった。また、制御の容易さ、制御の自由度、 運転の安定特性、制御の精度、制御の幅、制御の速度の向上等が望まれる状況に あった。 本発明は、上記の従来技術の問題点に鑑みてなされたもので、制御特性を大幅に向上させた内部循環流動床式のガス化炉を提供することを目的とする。

### 発明の開示

本発明は、例えば図1に示すように、高温の流動媒体 c を内部で流動させ、第 5 1の界面を有するガス化室流動床を形成し、前記ガス化室流動床内で被処理物 a をガス化するガス化室1と;高温の流動媒体 c を内部で流動させ、第2の界面を 有するチャー燃焼室流動床を形成し、ガス化室1でのガス化に伴い発生するチャ ーhを前記チャー燃焼室流動床内で燃焼させ流動媒体cを加熱するチャー燃焼室 2とを備え;ガス化室1とチャー燃焼室2とは、前記それぞれの流動床の界面よ 10 り鉛直方向上ガにおいてはガスの流通がないように仕切壁11、15により仕切 られ、仕切壁 1 1 、 1 5 の下部にはガス化室 1 とチャー燃焼室 2 とを連通する連 通口21、25であって、該連通口21、25の上端の高さは前記第1の界面お よび第2の界面以下である連通口21、25が形成され、該連通口21、25を 挟むガス化室1とチャー燃焼室2のうち一方の室の連通口21、25近傍におけ る流動媒体 c の流動化状態が、他方の室の連通口 2 1 、 2 5 近傍における流動媒 体cの流動化状態よりも強く、該連通口21、25を通じて、前記弱い流動化状 態の方から強い流動化状態の方に流動媒体cが移動するように構成され;さらに、 前記弱い流動化状態の流動の強弱を調節することにより、ガス化室1とチャー燃 焼室2との間で流通する流動媒体cの量を制御して、ガス化室1又はチャー燃焼 室2の温度を制御する制御装置6を備える;ガス化炉101を提供することを目 的とする。

このように構成すると、ガス化室1と、チャー燃焼室2と、制御装置6とを備えるので、弱い流動化状態の流動の強弱を調節することにより、ガス化室1とチャー燃焼室2の間で流通する流動媒体cの量を制御して、ガス化室1又はチャー燃焼室2の温度を制御することができる。制御装置6は、強い流動化状態の強さをも併せて調節するようにしてもよい。ガス化室1の温度は典型的にはガス化流動床の温度であり、チャー燃焼室2の温度は典型的にはチャー燃焼室流動床の温度である。また、弱い流動化状態の流動の強弱を調節するので、流動媒体cの量

15

20

を制御するために生じる流動化ガスg1、g2、g4の流量の変化が小さく、他の操業条件に大きな影響を与えることなくガス化室1またはチャー燃焼室2の温度を制御することができる。

流動床は典型的には炉底から吹き出す流動化ガスgにより流動化する。流動化ガスgの吹き出し速度、吹き出し量により流動化状態を調節できる。炉底には散気装置31~35を配置し、複数の区画1a、1b、2a、2b、4aに分割するとよい。流動化ガスg1、g2、g4の量を調節したい各区画毎に流動化ガスg1、g2、g4の流量を調節する調節弁61~65を設けてもよい。連通口21、25を挟むガス化室1とチャー燃焼室2のそれぞれの区画1a、1b、2a、2b、4aの調節弁61~65の開度を制御装置6により調節することにより、流動化ガスg1、g2、g4の吹き出し速度、吹き出し量を調節し流動化状態を調節できる。

ガス化炉101は、例えば、図1に示すように、被処理物 a を高温の流動媒体 c で然分解してガス b とチャートを生成するガス化室1と;ガス化室1で生成したチャートを燃焼して流動媒体 c を加熱するチャー燃焼室2とを備え;流動媒体 c はガス化室1とチャー燃焼室2との間で循環するように構成され;さらに、流動媒体 c の循環量を調節することにより、ガス化室1で発生するガス b の組成を制御する制御装置6を備えるものであってもよい。

このように構成すると、ガス化室1と、チャー燃焼室2と、制御装置6とを備えるので、流動媒体cの循環量を調節することにより、ガス化室1で発生するガスbの組成を制御することができる。当該制御装置6は、1種類のガス種の濃度を制御するものであってもよいし、複数のガスの濃度比を所定の設定値に制御するものであってもよい。

ガス化炉101は、例えば図1に示すように、高温の流動媒体 c を内部で流動 させ、第1の界面を有するガス化室流動床を形成し、前記ガス化室流動床内で被 処理物 a をガス化するガス化室1と;高温の流動媒体 c を内部で流動させ、第2の界面を有するチャー燃焼室流動床を形成し、ガス化室1でのガス化に伴い発生 するチャートを前記チャー燃焼室流動床内で燃焼させ流動媒体 c を加熱するチャー燃焼室2とを備え;ガス化室1とチャー燃焼室2とは、前記それぞれの流動床

10

20

の界面より鉛直方向上方においてはガスの流通がないように仕切壁11、15により仕切られ、仕切壁11、15の下部にはガス化室1とチャー燃焼室2とを連通する連通口21、25であって、該連通口21、25の上端の高さは前記第1の界面および第2の界面以下である連通口21、25が形成され、該連通口21、25を挟むガス化室1とチャー燃焼室2のうち一方の室の連通口21、25近傍における流動媒体cの流動化状態が、他方の室の連通口21、25近傍における流動媒体cの流動化状態が、他方の室の連通口21、25近傍における流動媒体cの流動化状態の方に流動媒体cが移動するように構成され; さらに、前記弱い流動化状態の方に流動媒体cが移動するように構成され; さらに、前記弱い流動化状態の流動の強弱を調節することにより、ガス化室1とチャー燃焼室2の間で流通する流動媒体cの量を制御して、前記ガス化により発生するガスbの組成を制御する制御装置6を備えるものであってもよい。

このように構成すると、ガス化室1と、チャー燃焼室2と、制御装置6とを備えるので、弱い流動化状態の流動の強弱を調節することにより、ガス化室1とチャー燃焼室2の間で流通する流動媒体cの量を制御して、ガス化により発生するガスbの組成を制御することができる。また、弱い流動化状態の流動の強弱を調節するので、流動媒体cの量を制御するために生じる流動化ガスg1、g2、g4の流量の変化が小さく、他の操業条件に大きな影響を与えることなくガス化室1より発生するガスbの組成を制御することができる。

ガス化炉101は、例えば、図1に示すように、さらにチャー燃焼室2から流動媒体 c を導入する熱回収室3であって、チャー燃焼室2からの流動媒体 c から熱を回収する熱回収装置41を有する熱回収室3と;該熱回収室3内の流動の強弱を調節することにより、熱回収装置41における熱回収量を制御する制御装置6を備えるものであってもよい。

このように構成すると、熱回収装置41を有する熱回収室3と、制御装置6と 25 を備えるので、制御装置6によって熱回収室3内の流動の強弱を調節することに より、熱回収装置41における熱回収量を制御することができる。熱回収室3は、 典型的にはチャー燃焼室2に隣接して設けられた熱回収室3である。熱回収装置 41は典型的には層内伝熱管41を含んで構成される。熱回収装置41は典型的 には回収した熱により蒸気s1を過熱する。制御装置6は過熱される蒸気s1の

15

20

25

量を制御するようにしてもよい。

ガス化炉101が、チャー燃焼室2に接して設けられた熱回収室3を備える場合は、チャー燃焼室2と熱回収室3との間には前記チャー燃焼室流動床の流動層部を仕切る仕切壁12が設けられ、仕切壁12の下部には開口部22が形成され、チャー燃焼室2の流動媒体cは仕切壁12の上部から熱回収室3に流入し、開口部22を通じてチャー燃焼室2に戻る循環流が形成されるように構成するとよい。ガス化炉101は、例えば、図1に示すように、さらに熱回収量を制御する制御装置6が、熱回収装置41における熱回収量を制御し、チャー燃焼室2の温度を制御するものであってもよい。

ガス化炉101は、例えば図1に示すように、さらにガス化室1の第1の界面より上部の第1の圧力と、チャー燃焼室2の第2の界面より上部の第2の圧力とを測定する圧力測定装置81、82と;ガス化室1から発生するガスbの、ガス化室1から排出する第1の排出線速度と、およびチャー燃焼室2から発生する燃焼ガスeの、チャー燃焼室2から排出する第2の排出線速度とを調節する調節装置78、79と;前記第1の圧力と前記第2の圧力との圧力差を所定の値とするように調節装置78、79を制御する制御装置6とを備えるものであってもよい。

このように構成すると、圧力測定装置 8 1、 8 2 と、調節装置 7 8、 7 9 と、制御装置 6 とを備えるので、圧力測定装置 8 1、 8 2 によって第 1 圧力と、第 2 の圧力とを測定し、調節装置 7 8、 7 9 によって第 1 の排出線速度と、第 2 の排出線速度とを調整し、制御装置 6 によって、第 1 の圧力と第 2 の圧力との圧力差を所定の値とするように調節装置 7 8、 7 9 を制御することができる。

第1の圧力と第2の圧力との圧力差を所定の値とすることができるので、ガス 化室1とチャー燃焼室2の間の流動媒体粒子の移動量に与える圧力の影響を一定 の値に抑えることができ、流動媒体粒子の移動量を精緻に制御することが容易と なる。なお、所定の値はほぼゼロに等しくてもよく、第1の圧力と第2の圧力と がほぼ等しくなるように制御装置6が調節装置78、79を制御するものであっ てもよい。

この出願は、日本国で2002年8月15日に出願された特願2002-23

6997号に基づいており、その内容は本出願の内容として、その一部を形成する。

また、本発明は以下の詳細な説明によりさらに完全に理解できるであろう。本 発明のさらなる応用範囲は、以下の詳細な説明により明らかとなるであろう。し かしながら、詳細な説明及び特定に実例は、本発明の望ましい実施の形態であり、 説明の目的のためにのみ記載されているものである。この詳細な説明から、種々 の変更、改変が、本発明の精神の範囲内において、当業者にとって明らかである からである。

出願人は、記載された実施の形態のいずれをも公衆に献上する意図はなく、開 の 示された改変、代替案のうち、特許請求の範囲内に文言上含まれないかもいれな いものも、均等論下での発明の一部とする。

### 図面の簡単な説明

図1は、統合型ガス化炉の構成を概念的に示すブロック図である。

15 図 2 は、仕切壁により仕切られた二つの室の模式的側面断面図である。仕切壁の形態により (a)、(b)、(c)に分類される。

図3は、流動化ガス速度とみかけの層粘性の関係を示す図である。

図4は、流動化ガス速度と流動媒体の移動量の関係を示す図である。

図5は、所定の弱流動化域と強流動化域とを所定の開口部の近傍域と遠隔域と 20 に分離した場合のブロック図である。

図6は、ガス化室と沈降チャー燃焼室の間を循環する流動媒体の循環量の定義を説明するための図である。

図7は、ガス化室と沈降チャー燃焼室の間の流動媒体の拡散を説明するための図である。

25 図8は、沈降チャー燃焼室の流動化ガスの空塔速度と、沈降チャー燃焼室からガス化室への熱移動量と循環量(対流)の関係を示す図である。

図9は、 沈降チャー燃焼室の流動化ガスの空塔速度と、沈降チャー燃焼室から ガス化室への流動媒体移動量(対流+拡散)の関係を示す図である。

図10は、流動層高と循環量の関係について説明する図である。

- 図11は、ケース1の場合の循環比とガス化室層温の関係を示す図である。
- 図12は、ケース2の場合の循環比とガス化室層温の関係を示す図である。
- 図13は、循環比と生成ガス組成の関係を示す図である。
- 図14は、循環比と生成ガスのH₂/CO比の関係を示す図である。
- 5 図15は、循環比と生成ガス発熱量の関係を示す図である。
  - 図16は、ガス化室層温とガス化室出口熱量割合の関係を示す図である。
  - 図17は、ガス化室層温と冷ガス効率の関係を示す図である。
  - 図18は、循環比と生成ガス発熱量の関係を示す図である。
- 図19は、ガス化室層温と、原料中の炭素がタールに移行する割合との関係を 10 示す図である。
  - 図20は、循環量と、原料中の炭素がチャー燃焼室へ移行する割合との関係を示す図である。
  - 図21は、ガス化室層温と、原料中の炭素がチャー燃焼室へ移行する割合との関係を示す図である。
- 15 図22は、流動媒体供給装置の構成を示すブロック図である。

## 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。

図1は、ガス化炉としての統合型ガス化炉101の構成を概念的に示すブロッ20 ク図である。

統合型ガス化炉101は、被処理物としての廃棄物または固体燃料 a を熱分解ガス化するガス化室1と、ガス化室1において生成したチャー分 h を燃焼するチャー燃焼室2とを含んで構成され、ガス化室1において生成した可燃性ガスであるガスとしての生成ガス b と、チャー燃焼室2において生成した燃焼ガス e とを 統合型ガス化炉101の後段のガス利用装置(不図示)に分離して供給することを特徴とする。チャー燃焼室2は、チャー燃焼室本体部5と沈降チャー燃焼室 (流動媒体沈降室) 4とを含んで構成される。統合型ガス化炉101は、ガス化室1に接続されガス化室1で生成した生成ガス b を供給する生成ガス供給配管26と、チャー燃焼室本体部5に接続されチャー燃焼室本体部5で発生した燃焼ガ

ス e を供給する燃焼ガス供給配管 2 7 とを備える。統合型ガス化炉 1 0 1 は、さらに生成ガス供給配管 2 6 に設置され、生成ガス b のガス組成を測定するガス組成測定器 4 6 を備える。

統合型ガス化炉101は、生成ガス供給配管26に設置され、生成ガス供給配管26から排出される生成ガスbの排出線速度(第1の排出線速度)を調整する調整装置としての調節弁78(例えば、ダンパ)と、燃焼ガス供給配管27に設置され、燃焼ガス供給配管27から排出される燃焼ガスeの排出線速度(第2の排出線速度)を調整する調整装置としての調節弁79(例えば、ダンパ)とを備える。

本統合型ガス化炉101は、前述の熱分解ガス化、チャー燃焼の機能をそれぞれ担当するガス化室1、チャー燃焼室2に加え、熱回収の機能を担当する熱回収室3を備え、ガス化室1、チャー燃焼室2、熱回収室3は、例えば全体が円筒形又は矩形を成した炉体内に収納されている。本統合型ガス化炉101は、後述の調節弁61、62、63、64、65、66、67(61~67)をそれぞれ制御する制御装置6を備える。制御装置6は、前述の調節弁78、79をも制御する。ガス化室1、チャー燃焼室2、熱回収室3は仕切壁11~15で分割されており、それぞれの底部に高温の流動媒体cを含む濃厚層である流動床が形成される。

ガス化室1、チャー燃焼室本体部5には、それぞれの濃厚層の層温を測定する温度測定器42、43が設置されている。本実施の形態では、ガス化室1の濃厚層の層温が、ガス化室1の温度であり、チャー燃焼室本体部5の濃厚層の層温がチャー燃焼室2の温度であるとしている。温度測定器42、43は、測定された温度に基づく温度信号i3(図中、破線で部分的に表示)を制御装置6に送る。制御装置6は、後述のように、温度信号i3に基づきガス化室1の温度チャー燃焼室2の温度が設定された値になるよう、調節弁61~67を制御するように構成することができ、この場合制御装置6は、後述のように、ガス組成信号i4を制御装置6に送る。制御装置6は、後述のように、ガス組成信号i4を制御装置6に送る。制御装置6は、後述のように、ガス組成信号i4を制御装置6に送る。制御装置6は、後述のように、ガス組成信号 i4に基づき生成ガスbのガス組成が設定された値になるよう、調節弁61~67を制御するように構成することができ、この場合制御装置6は、本発明の、ガ

20

スの組成を制御する制御装置である。温度測定器 4 2 、 4 3 は、熱電対を使用している。

ガス化室1、チャー燃焼室本体部5には、それぞれのフリーボード部の圧力を 測定する圧力測定器81、82が設置されている。ガス化室1のフリーボード部 の圧力が本発明の第1の圧力であり、チャー燃焼室本体部5のフリーボード部の 圧力が本発明の第2の圧力である。なお、フリーボード部については後述する。 圧力測定装置81、82は、測定された圧力に基づく圧力信号i5(図中、破線 で部分的に表示)を制御装置6に送る。制御装置6は、圧力信号i5に基づき、 ガス化室1の圧力と、チャー燃焼室2の圧力を所定の値とするよう、調節弁61 ~67を制御するように構成することができる。

ガス組成信号 i 4 は、 $H_2$ 、CO、 $CO_2$ 、 $CH_4$ 、 $H_2O$ 等のモル%とするとよい。制御装置 6 は、ガス組成信号 i 4 を得て、 $H_2/C$  O 比等を計算し、さらにガス組成信号 i 4 と、温度測定器 4 2 により測定された生成ガス b の温度信号 i 3 と、圧力測定器 8 1 により測定された生成ガス b の圧力信号 i 5 とにより生成ガス b のガスの発熱量を計算するように構成するとよい。

各室1~3の流動床、即ちガス化室流動床、チャー燃焼室流動床、熱回収室流動床の流動媒体cを流動させるために、各室1~3の底である炉底には、流動媒体c中に流動化ガスg1、g2、g3、g4(流動化ガスg1、g2、g3、g4の区別は後述する、以下流動化ガスを総称する場合は符号gをつける)を吹き込む散気装置31~36が設けられている。即ち、ガス化室1には散気装置31、32が、チャー燃焼室2には散気装置33、34、35が、熱回収装置3には散気装置36が設けられている。各散気装置31~36は、散気装置31~36が設置されている炉底部に敷かれた例えば多孔板を含んで構成され、該多孔板を広さ方向に区分して複数の部屋に分割されている。

25 統合型ガス化炉101は、散気装置31に接続された供給配管51、散気装置32に接続された供給配管52、散気装置33に接続された供給配管53、散気装置34に接続された供給配管54、散気装置35に接続された供給配管55、散気装置36に接続された供給配管56を備える。供給配管51~56は、それぞれ調節装置としての調節弁61~66と、流量測定器71~76とを備え、流

動化ガスgを各散気装置31~36へ供給する。調節弁61~66は、各散気装置31~36への流動化ガスgの供給量を調節する。よって、各散気装置31~36は、各室1~3内の各部(図中、室1の1a、1bで示す箇所、室2の2a、2b、4aで示す箇所、室3の3aで示す箇所)の空塔速度を変えるために、散気装置31~36の各部屋から多孔板を通して吹き出す流動化ガスgの流速を変化させるように構成されている。流量測定器71~76は、各供給配管51~56の調節弁61~66の下流側に設置され、流動化ガスgの流量を測定する。調節弁61~66は、制御装置6から送られる別々の制御信号i1(図中、破線で部分的に表示)を受けてそれぞれ作動し開度を変える。流量測定器71~76は、測定された流量に基づく流量信号i2(図中、破線で部分的に表示)を制御装置6に送る。

また、空塔速度は、室1~3の各部で相対的に異なるので各室1~3内の流動 媒体 c も室1~3の各部で流動化状態が異なり、そのため内部旋回流が形成され る。また室1~3の各部で流動化状態が異なるところから、内部旋回流は、炉内 の各室1~3を循環する。図中、散気装置31~36に示す白抜き矢印の大きさ は、吹き出される流動化ガスgの流速を示している。例えば2bで示す箇所の太 い矢印は、2aで示す箇所の細い矢印よりも流速が大きい。また、白抜きの矢印 で示される箇所の流速は、その箇所の全体に渡り均一である。

ガス化室1とチャー燃焼室本体部5の間は仕切壁11及び仕切壁15で仕切られ、ガス化室1と熱回収室3の間は仕切壁12で仕切られ、ガス化室1と熱回収室3の間は仕切壁13で仕切られている(なお本図は、炉を平面的に展開して図示しているため、仕切壁11はガス化室1とチャー燃焼室本体部5の間にはないかのように、また仕切壁13はガス化室1と熱回収室3の間にはないかのように示されている)。即ち、統合型ガス化炉101は、各1~3室が別々の炉として構成されておらず、一つの炉として一体に構成されている。さらに、チャー燃焼室本体部5のガス化室1と接する面の近傍には、流動媒体cが下降するべく沈降チャー燃焼室4を設ける。即ち、前述のようにチャー燃焼室2は沈降チャー燃焼室4と沈降チャー燃焼室4以外のチャー燃焼室本体部5とに分かれる。このため、沈降チャー燃焼室4をチャー燃焼室2の他の部分(チャー燃焼室本体

部5)と仕切るための仕切壁14が設けられている。また沈降チャー燃焼室4とガス化室1とは、図1に示すように、仕切壁15で仕切られている。

ここで、流動床と界面について説明する。流動床は、その鉛直方向下方部にある、流動化ガスgにより流動化状態に置かれている流動媒体 c (例えば珪砂)を 濃厚に含む濃厚層と、その濃厚層の鉛直方向上方部にある流動媒体 c と多量のガスが共存し、流動媒体 c が勢いよくはねあがっているスプラッシュゾーンとからなる。流動床の上方即ちスプラッシュゾーンの上方には流動媒体 c をほとんど含まずガスを主体とするフリーボード部がある。界面は、ある厚さをもった前記スプラッシュゾーンをいうが、またスプラッシュゾーンの上面と下面(濃厚層の上面)との中間にある仮想的な面ととらえてもよい。

また「流動床の界面より鉛直方向上方においてはガスの流通がないように仕切壁により仕切られ」というとき、さらに界面より鉛直方向下方の濃厚層の上面より鉛直方向上方においてガスの流通がないようにするのが好ましい。

ガス化室1とチャー燃焼室本体部5の間の仕切壁11は、炉の天井19から炉底(散気装置31の多孔板)に向かってほぼ全面的に仕切っているが、下端は炉底に接することはなく、炉底近傍に連通口としての開口部21がある。但しこの開口部21の上端が、第1の界面としてのガス化室流動床界面、第2の界面としてのチャー燃焼室流動床界面のいずれの界面よりも上部にまで達することはない。さらに好ましくは、開口部21の上端が、ガス化室流動床の濃厚層の上面、チャー燃焼室流動床の濃厚層の上面のいずれよりも上部にまで達することはないようにする。言い換えれば、開口部21は、常に濃厚層に潜っているように構成するのが好ましい。即ち、ガス化室1とチャー燃焼室2とは、少なくともフリーボード部においては、さらに言えば界面より上方においては、さらに好ましくは濃厚層の上面より上方ではガスの流通がないように仕切壁により仕切られていることになる。

またチャー燃焼室2と熱回収室3の間の仕切壁12はその上端が界面近傍、即ち濃厚層の上面よりは上方であるが、スプラッシュゾーンの上面よりは下方に位置しており、仕切壁12の下端は炉底近傍までであり、仕切壁11と同様に下端が炉底に接することはなく、炉底近傍に濃厚層の上面より上方に達することのな

10

15

20

い開口部22がある。言い換えれば、チャー燃焼室2と熱回収室3の間は流動層部のみ仕切壁12で仕切られており、その仕切壁12の炉床面近傍には開口部22を有し、チャー燃焼室2の流動媒体cは仕切壁12の上部から熱回収室3に流入し、仕切壁12の炉床面近傍の開口部22を通じて再びチャー燃焼室2に戻る循環流を有するように構成されている。

ガス化室1と熱回収室3の間の仕切壁13は炉底から炉の天井にわたって完全に仕切っている。沈降チャー燃焼室4を設けるべくチャー燃焼室2内を仕切る仕切壁14の上端は流動床の界面近傍で、下端は炉底に接している。仕切壁14の上端と流動床との関係は、仕切壁12と流動床との関係と同様である。沈降チャー燃焼室4とガス化室1を仕切る仕切壁15は、仕切壁11と同様であり、炉の天井から炉底に向かってほぼ全面的に仕切っており、下端は炉底に接することはなく、炉底近傍に連通口としての開口部25があり、この開口の上端が濃厚層の上面より下にある。即ち、開口部25と流動床の関係は、開口部21と流動床の関係と同様である。

15 ガス化室1に投入された廃棄物または固体燃料 a は流動媒体 c から熱を受け、熱分解、ガス化され、生成ガス b が生成される。典型的には、廃棄物または燃料 a はガス化室1 では燃焼せず、いわゆる乾留される。残った乾溜チャートは流動 媒体 c と共に仕切壁1 1 の下部にある開口部2 1 からチャー燃焼室本体部5 に流入する。このようにしてガス化室1 から導入されたチャートはチャー燃焼室本体 20 部5 で燃焼して流動媒体 c を加熱する。チャー燃焼室本体部5 でチャートの燃焼 熱によって加熱された流動媒体 c は仕切壁1 2 の上端を越えて熱回収室3 に流入し、熱回収室3 内で界面よりも下方にあるように配設された熱回収装置としての 層内伝熱管41 で収熱され、冷却された後、再び仕切壁12の下部の開口部22 を通ってチャー燃焼室本体部5 に流入する。

25 層内伝熱管 4 1 は、熱回収室 3 内に配置された層内伝熱管本体 4 1 A と、蒸気 s 1 を層内伝熱管本体 4 1 A に導く導入部 4 1 B と、層内伝熱管本体 4 1 A から 過熱蒸気 s 2 を排出する排出部 4 1 C からなる。層内伝熱管本体 4 1 A に導入された蒸気 s 1 は過熱され過熱蒸気 s 2 となる。

統合型ガス化炉101は、温度測定器44、45と、調節弁67と、流量測定

器77とを備える。温度測定器44は、導入部41Bに設置され、蒸気 s1の温度を測定する。調節弁67は、導入部41Bに設置され、蒸気 s1の流量を制御する。流量測定器77は、導入部41Bに設置され、蒸気 s1の流量を測定する。温度測定器45は、排出部41Cに設置され、過熱蒸気 s2の温度を測定する。調節弁67は、制御装置6から送られる制御信号i1(図中、破線で部分的に表示)を受けて作動し開度を変える。流量測定器77は、測定された流量に基づく流量信号i2(図中、破線で部分的に表示)を制御装置6に送り、温度測定器44、45は、測定された温度に基づく温度信号i3(図中、破線で部分的に表示)を制御装置6に送る。制御装置6は、本発明の熱回収量を制御する制御装置である。

ここで、熱回収室3は本発明の実施の形態である統合型ガス化炉101において必須ではない。即ち、ガス化室1で主として揮発成分がガス化した後に残る主としてカーボンからなるチャートの量と、チャー燃焼室2で流動媒体cを加熱するのに必要とされるチャーの量がほぼ等しければ、流動媒体cから熱を奪うことになる熱回収室3は不要である。また前記チャートの量の差が小さければ、例えば、ガス化室1でのガス化温度が高目になり、ガス化室1で発生するCOガスの量が増えるという形で、バランス状態が保たれる。

しかしながら図1に示すように熱回収室3を備える場合は、チャートの発生量の大きい石炭から、ほとんどチャートを発生させない都市ゴミまで、幅広く多種類の廃棄物または燃料aに対応することができる。即ち、どのような廃棄物または燃料aであっても、熱回収室3における熱回収量を加減することにより、チャー燃焼室本体部5の燃焼温度を適切に調節し、流動媒体cの温度を適切に保つことができる。また、流動化ガスg3の散気装置36への供給量を調節弁66によって調節し、弱い流動化状態に維持される弱流動化域3aを有する熱回収室3内の流動化状態の強弱を調節することにより、熱回収室3における熱回収量を制御することができる。よって、熱回収量を制御する制御装置6が、層内伝熱管41における熱回収量を制御し、チャー燃焼室2の温度を制御する。

一方チャー燃焼室本体部5で加熱された流動媒体cは仕切壁14の上端を越えて沈降チャー燃焼室4に流入し、次いで仕切壁15の下部にある開口部25から

10

20

ガス化室1に流入する。

ここで、図2(a)、(b)、(c)の模式的側面断面図を参照して、炉F内に形成された仕切壁X、仕切壁Yあるいは仕切壁Zで仕切られた二つの室Ra、Rb間の流動媒体cの流動化状態及び移動について説明する。図2(a)では、こつの室Ra、Rbは、上部のみに開口部Pxを有する仕切壁Xによって仕切られる。図2(b)では、二つの室Ra、Rbは、下部にのみ開口部Qyを有する仕切壁Yによって仕切られる。図2(c)では、二つの室Ra、Rbは、上部に開口部Pz、さらに下部に開口部Qzを有する仕切壁Zによって仕切られる。図2(a)、(b)、(c)において、共に、流動媒体cを収納する各室Ra、R10 bの炉底には、それぞれ流動化ガスga、gbを吹き込む散気装置Da、Dbが、設けられている。また、仕切壁X、2の上端は、界面の高さ近傍にあり、開口部Qy、Qzは、濃厚層に潜った位置にあるものとする。また、図2(a)、(b)、(c)において、室Ra内の流動化状態は、室Ra内で均一であり、室Rb内の流動化状態は、室Rb内で均一であるとする。

15 仕切壁 X、仕切壁 Y あるいは仕切壁 Z により仕切られた 2 室 R a 、 R b 間の流動媒体 c の移動は、室 R a 側と室 R b 側との流動化状態の強弱差により引き起こされるので、室 R a 側と室 R b 側との流動化状態の強弱差を実用上任意に変えることにより、室 R a と室 R b 間の開口部 P x 、 Q y 、 P z 、 Q z を介した流動媒体 c の移動量と移動方向(室 R a から室 R b へ、あるいは室 R b から室 R a へ) を調節することができる。以下では、室 R a と室 R b の流動化状態をどのように変えた場合に、室 R a と室 R b 間の流動媒体 c の移動量をどのように調節できるかについて具体的に説明する。

なお、開口部Qy、Qzを介して移動する、室Raと室Rb間の流動媒体cの移動は、一般的には室Ra側の開口部Qy、Qz近傍における流動化状態と、室Rb側の開口部Qy、Qz近傍における流動化状態の強弱差に影響され、弱い流動化状態の室から強い流動化状態の室へ、流動媒体cが移動する。図2(a)、(b)、(c)では、室Ra内の流動化状態が室Ra内で均一であり、また室Rb内の流動化状態が室Ra内で均一であり、また室Rb内の流動化状態が室Rb内で均一であるので、室Ra内、室Rb内の流動化ガスga、gbのガス速度の差で論じることができ、ガス速度の遅い室から、ガス

速度の速い方の室へ、流動媒体cが移動する。

まず、図2(a)を参照して、2室Ra、Rbが、上端が界面の高さ近傍にある仕切壁Xによって仕切られる場合について説明する。2室Ra、Rbの流動化状態が等しい場合は、室Ra側からはねあがった流動媒体cが仕切壁Xを越えて室Rb側に移動する量と、室Rb側からはねあがった流動媒体cが仕切壁Xを越えて室Ra側へ移動する量が平均的に等しくなる。よって、局所的には2室Ra、Rb間の流動媒体cの移動は生じているが、全体的(室Ra、及び室Rbそれぞれ全体、以下同様)には流動媒体cの移動量は0となる。

例えば、室Rbの流動化状態を一定に保ったまま、室Raの流動化状態を室R bの流動化状態よりも強くした場合、即ち室Rbの流動化ガス速度を一定に保っ たまま室Raの流動化ガス速度を室Rbの流動化ガス速度よりも大きくした場合、 室Ra側からはねあがった流動媒体 c が仕切壁 X を超えて室Rb側へ移動する量 より、室Rb側からはねあがった流動媒体 c が仕切壁 X を超えて室Ra側へ移動 する量が多くなるため、室Ra側から室Rb側への全体的な流動媒体 c の移動量 は0とはならず、室Ra側から室Rb側への流動媒体 c の移動が生じる(図中、 この状態を白抜き矢印で表示している)。

なお、ここでは室Rbの流動化ガス速度を一定に保ったまま室Raの流動化ガス速度を大きくするように変化する場合を考えたが、逆に室Raの流動化ガス速度を一定に保ったまま室Rbの流動化ガス速度を小さくするように変化させても、同様の効果が得られる。

いま、室Ra、室Rbにおいて流動媒体 c の外部からの補充や、外部への抜き 出しを行わないものとすると、室Ra側から室Rb側への流動媒体 c の移動によ り、室Raの流動層高は次第に低下し、室Rbの流動層高は次第に上昇すること になる。

25 室 R a 側からはねあがり仕切壁 X を超えて室 R b 側へ移動する流動媒体 c の量は、室 R a 側の流動層界面が低くなるほど減少するから、上述の室 R a の流動層高の低下により、室 R a 側から室 R b 側への流動媒体 c の移動量は減少する。同様に、室 R b 側からはねあがりが仕切壁 X を超えて室 R a 側へ移動する流動媒体 c の量は、室 R b 側の流動層界面が高くなるほど増加するから、上述の室 R b の

15

20

25

流動層高の上昇により、室Rb側から室Ra側への流動媒体cの移動量は増加する。

このため、室Raと室Rbの流動化ガスga、gbのガス速度が同じである場合を初期状態として、室Raの流動化ガス速度が室Rbの流動化ガス速度より大きくなるように一定量の差をつけた場合、始めは室Ra側から室Rb側への全体的な流動媒体 cの移動が生じるが、ある程度室Raの流動層高が低下し、室Rbの流動層高が上昇した段階において、再度室Ra側から室Rb側への局所的な流動媒体 cの移動量と室Rb側から室Ra側への局所的な流動媒体 cの移動量が全体として釣り合うことにより、2室Ra、Rb間の流動媒体 cの全体的な移動量は再び0となる。

したがって、室Raの流動化ガス速度が、室Rbの流動化ガス速度より大きくなるように一定量の工をつけた場合において、室Raから室Rbへの流動媒体 c の移動を連続的に行うためには、両室Ra、Rbに充填されている流動媒体 c の量、即ち流動層高が一定となるように、外部から室Raへ流動媒体 c が供給され、かつ室Rbから外部へ流動媒体 c が抜き出されるような構成とすればよいことになる。

この場合、室Raと室Rbの流動化ガス速度の差を大きくするほど室Raから室Rbへの流動媒体cの移動量を大きく確保することができるため、室Rbの流動化を止めた状態または最低流動化に近い状態、即ち好ましくは流動化速度が2Umf以下、さらに好ましくは1Umf以下になるようにし、室Raの流動化速度をこれに比べて十分高い状態、好ましくは流動化速度が4Umf以上、さらに好ましくは5Umf以上に保った場合に最大の流動媒体cの移動量を確保することができる。ここで、Umfとは最低流動化速度(流動化が開始される流動化ガスの速度)を1Umfとした単位である。即ち、5Umfは最低流動化速度の5倍の速度である。

次に、図2(b)に示すように、2室Ra、Rbが濃厚層に潜った開口部Qyを有する仕切壁Yによって仕切られている場合について考える。2室Ra、Rb の流動化状態等しい場合(室Raの流動化ガス速度と、室Rbの流動化ガス速度 とが等しい場合)は、開口部Qyを介しての室Ra側から室Rb側への、あるい は室Ra側から室Rb側への流動媒体cの拡散量は釣り合うため、局所的には2室Ra、Rb間の流動媒体cの移動は生じているけれども、全体的な流動媒体cの移動量は0である。

室Rbの流動化状態を同一に保ったまま、室Raの流動化状態を室Rbの流動化状態よりも強くした場合、即ち室Rbの流動化ガス速度を一定に保ったまま室Raの流動化ガス速度を室Rbの流動化ガス速度よりも大きくした場合、室Raの濃厚層内には室Rbの濃厚層内に比べより多量の気泡が発生するため、室Raのみかけの層密度は室Rbのみかけの層密度に比べて低下する。このため、室Raと室Rbの各々の流動層高が等しければ、室Raの層下部の開口部Qy近傍における圧力は、室Rbの層下部の開口部Qy近傍における圧力より低くなる。この圧力差を駆動力とする誘引作用により、室Rb側から室Ra側へと流動媒体cの移動が開口部Qy全体に渡って生じる(図中、この状態を白抜き矢印で表示している)。

逆に、室Raの流動化ガス速度を一定に保ったまま室Rbの流動化ガス速度を 小さくした場合は、若干状況が異なる。ここで考えている流動媒体 c の移動は、 濃厚層内に設けられた仕切壁 Y の開口部 Q y を介して生じており、室 Raと室 R b の層下部の開口部 Q y 近傍における圧力差がその駆動力となっている。言い換 えれば、室 Raと室 Rbの層下部の開口部 Q y 近傍における圧力差が、流動媒体 c が開口部 Q y を通過して移動するのに必要な抵抗力と釣り合っていることにな 20 るが、この抵抗力は、粒子層のみかけの層粘性と密接な関係がある。

次に、図2(b)、図3、図4を参照して説明する。

図3に、流動媒体 c の流動化状態と粒子層のみかけの層粘性との関係を示す。 室R b の流動化ガスg b のガス速度を、図3に示す範囲で変化させ、一方、室R a の流動化ガスg a のガス速度は、一定に保った場合を示している。単純バブリング流動層(沈降流なし)の場合、流動化ガス速度が1 Umf以下の固定層では流動層の粘性が無限大にほぼ等しくなる。流動化ガス速度が1 Umf以上で流動層の粘性が急激に減少する。室R b (沈降室)の場合、沈降する流動媒体と上昇する流動化ガスの相対速度が生じるので、流動化ガス速度が、1 Umf以下でも、流動化ガス相対速度が、1 Umf以上の流動層となるので、粘性が変化し、移動量

25

10

(循環量) が制御できる。よって、流動媒体 c の移動量(循環量)を制御するた めの流動化ガス量の変化量を最小にすることができる。すなわち、循環量を制御 するためのプロセス因子(ここでは流動化ガス量)の変化が、他のプロセス因子 に及ぼす影響を最小にすることができる。

したがって、室Raの流動化ガス速度を一定に保ったまま室Rbの流動化ガス 速度を小さくした場合、室Rbの流動化ガス速度の絶対値に応じて、流動媒体 c の移動量の変化の挙動が異なる。初期状態において、室Ra及び室Rbの双方が 十分強流動化した状態、即ち流動化ガス速度が 5 Umfを超える状態にあったと する。この状態から、室Rbの流動化ガス速度を減じてゆくと、室Rbの流動化 ガス相対速度(流動媒体の沈降速度と流動化ガスの上昇速度との相対速度)が2 Umf程度を超える範囲では、室Rbの流動化ガス速度を小さくするほど、室R a と室Rbの層下部の開口部Py近傍における圧力差が大きくなるため、室Rb から平Raへの流動媒体cの移動量が大きくなる。しかし、室Rbの流動化ガス 相対速度 (流動媒体の沈降速度と流動化ガスの上昇速度との相対速度) が 2 Umf 15 程度より小さい範囲では、室Rbの流動化ガス速度が小さいほど、層粘性が急激 に大きくなり、流動媒体cが仕切壁Yの開口部Qyを通過するための抵抗力が大 さくなるため、室Rbから室Raへの流動媒体 c の移動量は逆に小さくなる。

☑4に、室Raの流動化ガスgaのガス相対速度(流動媒体の沈降速度と流動 化ガスの上昇速度との相対速度)を、一定に保った場合(4 Umf、5 Umf、6 Umfの3つのケースをそれぞれ示す)に、室Rbの流動化ガスgbのガス速度 を変化させた場合に、室Raから室Rbへの流動媒体cの移動量がどのように変 化するかを示す。図4に示すように、室Rbの流動化ガス相対速度(流動媒体の 沈降速度と流動化ガスとの相対速度)が 2 Umf程度より小さい範囲において、 流動化ガス相対速度(流動媒体の沈降速度と流動化ガスの上昇速度との相対速 度)に対して、ほぼ線形的に流動媒体 c の移動量が変化することがわかる。即ち、 この範囲を積極的に利用することにより、少ない流動化ガス量のもとで、流動化 ガス量のわずかな変化により大きな流動媒体cの移動量の変化を引き起こすこと ができる。また、図4では室Raの流動化状態が一定に保たれている場合を示し ているが、本図のように室Raの流動化状態は十分強い流動化の状態に保たれて

いることが特に好ましい。

発明者らの知見によれば、図4における室Raから室Rbへの流動媒体cの移 動量の最大値を与える流動化ガスgbのガス相対速度(流動媒体の沈降速度と流 動化ガスとの相対速度)は約1.7Umfである。以上の観点からは、室Rbの流動 化ガス相対速度(流動媒体の沈降速度と流動化ガスとの相対速度)は好ましくは  $1Umf\sim 2Umf$ の範囲、さらに好ましくは $1Umf\sim 1.7Umf$ の範囲で調整するのが よく、また室Raの流動化ガス速度は、好ましくは4Umf以上、さらに好ましく は5Umf以上に保つのがよい。

なお、室Rbの流動化ガスgbのガス速度を一定に保ったまま室Raの流動化 ガスgaのガス速度を大きくした場合でも、あるいは室Raの流動化ガスgaの 10 ガス速度を一定に保ったまま室Rbの流動化ガスgbのガス速度を小さくした場 合でも、流動媒体cの外部からの補充や、外部への抜き出しを行わないものとす ると、室Rb側から室Ra側への流動媒体cの移動により、室Rbの流動層高は 低下し、室Raの流動層高は上昇することになる。

即ち、室Raと室Rbの流動化ガス速度が同じである場合を初期状態として、 室Ra側の流動化ガス速度が室Rb側の流動化ガス速度より大きくなるように、 一定量の差をつけた場合、差をつけた直後は室Rb側から室Ra側への流動媒体 c の移動が生じるが、ある程度室R a の流動層高が上昇し、室R b の流動層高が 低下すると、室Raの層下部の開口部Qy近傍における圧力が高くなり、室Rb の層下部の開口部Qy近傍における圧力が低くなるため、流動媒体cの移動の駆 20 動力であった室Raと室Rbの層下部の開口部Qy近傍における圧力差が小さく なる。この圧力差が0となった段階において、2室Ra、Rb間の流動媒体cの 全体的な移動量は再び0となる。

したがって、室Raの流動化ガス速度が、室Rbの流動化ガス相対速度(流動 媒体の沈降速度と流動化ガスの上昇速度との相対速度)より大きくなるように一 25 定量の差をつけた場合において、室Rbから室Raへの流動媒体cの移動を連続 的に行うためには、両室Ra、Rbに充填されている流動媒体cの量、即ち流動 層高が一定となるように、外部から室Rbへ流動媒体cが供給され、かつ室Ra から外部へ流動媒体cが抜き出されるような構成とすればよいことになる。

次に、図2(c)を参照して説明する。図2(c)では、上部に開口部Pzを、下部に開口部Qzを有するので、上部の開口部Pzでは、図2(a)に関し前述した現象が生じ、下部の開口部Qzでは、図2(b)に関し前述した現象が生じる。

したがって、例えば、室Rbの流動化状態を一定に保ったまま、室Raの流動化状態を室Rbの流動化状態よりも強くした場合、逆に室Raの流動化ガス速度を一定に保ったまま室Rbの流動化ガス相対速度(流動媒体の沈降速度と流動化ガスとの相対速度)を小さくするように変化させた場合、開口部Pzでは、室Ra側から室Rb側への流動媒体cの移動が生じ、開口部Qzでは、室Ra側から室Rb側への流動媒体cの移動が生じ、開口部Qzでは、室Ra側から

この場合、開口部Qzを介する流動媒体cの移動量と、開口部Pzを介する流動媒体cの移動量は、室Raの流動化状態を室Rbの流動化状態よりも強くした初期の状態では、必ずしも等しくはない。しかし、ある過渡状態を経た後には、流動媒体cの移動量の相違に起因する流動層高の変化により、各々の開口部Qz、Pzを介する流動媒体cの移動量が等しくなり、ある定常的な流動媒体cの循環状態が得られる。

例えば、開口部Qzを介する流動媒体 c の室 R b から室 R a への移動量が、開口部 P z を介する流動媒体 c の室 R a から室 R b への移動量よりも大きい場合について考える。この場合、室 R b の流動層高は次第に低くなり、同時に室 R a の流動層高は次第に高くなる。室 R b の流動層高の低下は室 R b の炉床近傍の圧力を低下させ、一方で室 R a の流動層高の低下は室 R a の炉床近傍の圧力を低下させ、一方で室 R a の流動層高の上昇は室 R a の炉床近傍の圧力を出る。これにより、開口部 Q z を挟んだ室 R a と室 R b の圧力差が小さくなり、すなわち開口部 Q z を介した室 R b から室 R a への流動媒体 c の移動量は減少する。また、室 R a の流動層高が上昇することにより、仕切壁 Z の上端を超えて室 R a から室 R b へ流動媒体 c が飛び込みやすくなる。即ち、開口部 P z を介する流動媒体 c の室 R b から室 R a への移動量は減少し、開口部 P z を介する流動媒体 c の室 R b から室 R a への移動量は減少し、開口部 P z を介する流動媒体 c の室 R b から室 R a への移動量は増加するため、室 R a と室

Rbの流動層高はさらに変化し、流動媒体 c の室 R b から室 R a への移動量と室 R a から室 R b への移動量が等しくなるところでバランスする。

以上において、最終的にバランスして得られた流動媒体 c の移動量(循環量)は、開口部 Q z の幅、高さ、面積及び形状と、仕切壁 Z の高さなどの炉 F の形状の条件と、各室に供給する流動化ガス量によって決まる。したがって、所望の循環量が得られるようにするためには、流動化ガス量の供給量を考慮して、開口部Q z の幅、高さ、面積及び形状と、仕切壁 Z の高さなどの炉 F の形状を決定すれば良い。

ここで、図6を参照して、ガス化室1と沈降チャー燃焼室4との間を開口部2 5を通って循環する流動媒体 c の循環量の定義について以下説明する。図中、ガス化炉101は、図1に記載されたものと同じ構成であるが、説明をわかりやすくするため、ガス化室1の強流動化域1bと、弱流動化域4aである沈降チャー燃焼室4と、開口部25が形成された仕切壁15とで構成されるように記載され、他の構成要素は省略してある。

ガス化室1の強流動化域1bの流動化ガスg1(図1)の空塔速度をV1bとし、弱流動化域4aである沈降チャー燃焼室4の流動化ガスg4(図1)の空塔速度をV4aとする。空塔速度V1bは、空塔速度V4aより大きいので(V1b>V4a)、ガス化室1の流動化状態は、沈降チャー燃焼室4の流動化状態より強く、沈降チャー燃焼室4の炉底部B4aとガス化室1の強流動化域1bの炉底部B1bとにおいて圧力差がつき、両流動化域の間に存在する仕切壁15の下部の開口部25を通り流動媒体cが循環し移動する。炉底部圧力(炉底部における流動層圧力)をPm[Pa]、流動層のかさ密度をDf[kg/m³]、重力加速度をga[kg/s²]、流動層の高さ(層高)をHf[m]とすれば、

Pm=Df×ga×Hf···(1) の関係が成立する。

25 沈降チャー燃焼室4は弱流動化域4aであり、気泡が少ないため、流動層かさ密度Df4aが大きい(空隙が少なく、粒子濃度が濃い)。一方、ガス化室1の強流動化域1bでは、気泡が多いため、流動層かさ密度Df1bが小さい(空隙が多く、粒子密度が薄い)。よって、沈降チャー燃焼室4(弱流動化域4a)の流動層かさ密度Df4aは、ガス化室1の強流動化域1bの流動層かさ密度Df1

15

bよりも大きくなり(Df4a>Df1b)、圧力差が生じて、チャー燃焼室4 (弱流動化域4a)からガス化室1の強流動化域1bの方へ流動媒体cが移動する。 これに対して、図7に示すように、ガス化室1の強流動化域1bの空塔速度V 1bが、沈降チャー燃焼室4の空塔速度V4aに等しいとき(V1b=V4a)は、 ガス化室1の強流動化域1bの炉底部B1bにおける炉底部圧力Pm1bは、沈 降チャー燃焼室4の炉底部B4aにおける炉底部圧力Pm4aに等しくなる(Pm 1b=Pm4a)ので、仕切壁15の下部の開口部25では、マクロ的にみると沈 降チャー燃焼室4からガス化室1の強流動化域1bへの流動媒体cの移動も、ガ

10 しかし、流動層内のすべての流動化域で同じ空塔速度である流動層において、 ミクロ的に1個1個の粒子に着目すると、粒子は任意の方向に絶えず移動してい るので、ガス化室1と沈降チャー燃焼室4の間の仕切壁15の下部の開口部25 にて、ガス化室1と沈降チャー燃焼室4との間を流動媒体粒子cの双方向の流れ が生じ、流動媒体粒子cの交換が生じている。

ス化室1から沈降チャー燃焼室4への流動媒体cの移動も生じない。

15 図6のようなガス化室1と沈降チャー燃焼室4との間の流動媒体cのマクロな 一方向の移動を対流と称することにする。図7のような流動媒体cのガス化室1 と沈降チャー燃焼室4との間の双方向の粒子の移動を拡散と称することにする。 図6の対流が生じている領域でも、ミクロな領域での1個1個の粒子に着目する と、図7のような拡散が生じている。

20 これに対し、図6にようなマクロな一方向流れの質量流量[kg/s]を循環量と定義する。この循環量は、流動層の炉底部の圧力差と、上流側の流動層の粘性と下流側の流動層の粘性によって定まる(特に、上流側の流動層の粘性が支配的である)。図6において、沈降チャー燃焼室4の炉底部B4aの炉底部圧力Pm4aと、ガス化室1の炉底部B1bの炉底部圧力Pm1bとの差が大きいほど、仕切25 壁15の下部の開口部25を通じて、沈降チャー燃焼室4からガス化室1への流動媒体 c の移動量(循環量)は、増加する。また、仕切壁15の下部の開口部25は、流動媒体 c の流れに対して絞り抵抗になる。したがって、沈降チャー燃焼室4の流動層のみかけの粘性が小さいほど、開口部25での絞り抵抗を流動媒体 c が流れやすくなり、循環量が増加する。流動層のみかけの粘性は、流動層の流

10

15

20

動化状態、すなわち流動化ガスの空塔速度V1b、V4aに依存して決まる。したがって、ガス化室1の強流動化域1bの流動化ガス速度V1bを変化させ、あるいは沈降チャー燃焼室4の流動化ガスの空塔速度V4aを変化させて、みかけの粘性を変化させることで、循環量を制御することができる。

例えば、ガス化室1の全領域の流動化状態と、沈降チャー燃焼室4の全領域の流動化状態とを同じにすれば、循環量は0になる。しかし、このようにして、循環量を0にしても、仕切壁15の下部の開口部25では拡散による2室1、4間の流動媒体cの交換が行われるので、この流動媒体cの交換に同伴して、ガス化室1の強流動化域1bの熱分解残渣(流動化しない大型の残渣は除く)は沈降チャー燃焼室4へ移動して、燃焼する。

したがって、吸熱反応である原料の熱分解が行われるガス化室1よりも、残渣燃焼が行われる沈降チャー燃焼室4の方が流動層温度が高くなる。仕切壁15の下部の開口部25では拡散による2室1、4間の流動媒体cの交換が行われるので、この流動媒体cの交換により、流動媒体cのもつ顕熱も、2室1、4間で交換される。したがって、温度の高い沈降チャー燃焼室4から、温度の低いガス化室1へ流動媒体cの顕熱が移動する。

以上のことから、沈降チャー燃焼室4の流動化ガス速度(流動化ガスの空塔速度)と、循環量(対流)および熱移動量とには、図8のような関係がある。すなわち、沈降チャー燃焼室4の流動媒体cの空塔速度が0になると、循環量(対流)は0になるが、熱移動量は0にはならない。これは、ガス化室1とチャー燃焼室本体部5の仕切壁11の下部の開口部21にて、ガス化室1とチャー燃焼室本体部5間の拡散による、流動媒体cの交換が生じ、それにともなって、残渣移動と熱移動が存在するからである。

図9に、流動媒体 c が沈降する弱流動化域 4 a である沈降チャー燃焼室 4 の流 動化ガスの空塔速度 (単位を Umf とする)を 0 Umf から約1. 7 Umf まで変化させたときの沈降チャー燃焼室 4 からガス化室 1 への流動媒体移動量 (対流 + 拡散) (単位 kg/s) の変化を示す。図に示すように、空塔速度の増加により流動媒体移動量がほぼ直線的に増加する。1Umf 以下でも、流動媒体移動量が変化し制御範囲内である。ここで、Umf とは最低流動化速度 (流動化が開始される流動

化ガスの空塔速度)を1Umfとした単位である。また、図中、沈降チャー燃焼室4の流動化速度を0にしたときに、沈降チャー燃焼室4から、ガス化室1への流動媒体移動量が0になっていない。これは、ガス化室1と沈降チャー燃焼室4の間の仕切壁15に形成された開口部25間の拡散による流動媒体移動が生じているためである。よって、沈降チャー燃焼室4の流動化状態を停止して、対流による熱移動量を0にして、ガス化室1と沈降チャー燃焼室4の開口部25周辺の流動化状態を変える(流動化ガス量を変える)ことにより、ガス化室1と沈降チャー燃焼室4の開口部25周辺での拡散による熱移動量を変化させることで、熱移動量をより小さい範囲で制御することが可能になる。

10 したがって、ガス化室1の弱流動化域1aで開口部21に近い領域と、チャー 燃焼室本体5の強流動化域2bで開口部21に近い領域に供給する流動化ガス 量g1、g2を測定する流量測定装置71、74と、その流量を変化させる流 量制御装置(例えば流量制御弁61、64)を設けることで、ガス化室1とチャー燃焼室本体5の開口部周辺での拡散による熱移動量を制御することが可能 15 になる。

例えば、熱移動量を小さい値に制御したい場合、熱移動量制御装置としての制御装置 6 は、沈降チャー燃焼室4の流動化ガス流量制御装置(例えば流量制御弁65)に流量を0にする信号を送る。その結果、沈降チャー燃焼室4の流動化は停止して、ガス化室1とチャー燃焼室2の間の対流による流動媒体の移動は起こらなくなる。さらに、熱移動量制御装置としての制御装置6は、ガス化室1の弱流動化域1aで開口部21に近い領域に供給する流動化ガスg1を制御する流動化ガス量制御装置(例えば流量制御弁61)と、チャー燃焼室本体5の強流動化域2bで開口部21に近い領域に供給する流動化ガスg2を制御する流動化ガス量制御装置(例えば流量制御弁63)に、流量を下げる信号を送る。その結果、ガス化室1の弱流動化域1aで開口部21に近い領域と、チャー燃焼室本体5の強流動化域2bで開口部21に近い領域の流動化ガス量が減少し、開口部21周辺での拡散が弱くなり、熱移動量が減少する。

図10を参照して、流動層高と循環量の関係について記述する。図中、炉10

2は、仕切壁Wに仕切られた二つの室Rpと室Rqを含んで構成される。室Rpと室Rqは流動媒体cを収納する。仕切壁Wには上部に開口部Pwが、下部に開口部Qwが形成されている。室Rpの炉底には流動化ガスを吹き込む散気装置Dpa、散気装置Dpbが設けられ、室Rqの炉底には流動化ガスを吹き込む散気装置Dpaが設けられている。仕切壁Wの上端は界面の高さの近傍にあり、開口部Qwは濃厚層に潜った位置にあるものとする。室Rpは散気装置Dpaの真上の流動化の状態の弱い弱流動化域paと、散気装置Dpbの真上の流動化状態の弱い弱流動化域pbとの二つの区画に区分される。室Rqは流動化状態の弱い弱流動化域qaである。また、流動化状態は、室Rpの弱流動化域pa内、室Rpの強流動化域pbは炉底部Bpbを有し、室Rqは炉底部Bqaを有するとする。

以下に示す2つの理由により、流動層高が高いほど、循環量は多くなる。前述したとおり、弱大動に域 q a である室 R q の炉底部 B q a における炉底部圧力 P m q a と、室 R p の独立動化域 p b の炉底部 B p b の炉底部圧力 P m p b との圧力差がつくことで、両铂域の間の仕切壁 W の下部の開口部 Q w から流動媒体が移動する。炉底部での圧力は前述のように、P m = D f × g a × H f · · · (1) から求められる。ここで、P m [Pa] が炉底部圧力、D f [kg/m³]が流動層のかさ弱流動化域 q a である室 R q では、気泡が少ないため、流動層かさ密度 D f q a が大きい(空隙が少なく、粒子濃度が濃い)。室 R p の強流動化域 p b では、気泡が多いため、流動層かさ密度 D f p b が小さい(空隙が多く、粒子密度が薄い)。よって、弱流動化域 q a である室 R q の流動層かさ密度 D f q a は、室 R p の強流動化域 p b の流動層かさ密度 D f p b よりも大きくなり (D f q a > D f p b)、よって室 R q の炉底部圧力 P m q a が、室 R p の強流動化域 p b の炉底部 B p b の炉底部圧力 P m p b よりも大きくなり (P m q a > P m p b )、圧力差が生じて、弱流動化域 q a である室 R q から室 R p の強流動化域 p b へ開口部 Q w を通って流動媒体が c 移動する。

(1)式により、流動層高が高いほど、それに比例して、室Rqの弱流動化域 qaの炉底部Bqaの圧力Pmqaと、室Rpの強流動化域pbの炉底部Bpb の圧力Pmpbとの圧力差が大きくなるので、流動層高が高いほうが移動量が多

10

15

くなる。室Rgから室Rpへ移動する流動媒体 c の移動量が多いほど、循環量は 多くなる(流動層高が高いほど、循環量が多くなる第一の理由)。

図10に示すように、室Rpの強流動化域pbの上部で気泡の破裂が起こり、この気泡の破裂によって流動媒体cが周囲に飛散し、室Rpから室RQへ開口部 Pwを通って流動媒体cの移動が生じる。流動層高が高いほど、室RQと室Rpの間の仕切壁Wの上端から流動層上面までの距離(図のΔ H)が高くなり、室Rpの上部での気泡の破裂に伴う流動媒体cの粒子の移動により、室RQへ移動する流動媒体cの量が多くなるので、循環量が多くなる(層高さが高いほど、循環量が多くなる第二の理由)。室Rpの上部での気泡の破裂により、流動媒体c が室RQへ移動する現象は、気泡の破裂する流動層上方付近のある限られた範囲で起こるので、ある値以上に、流動層高を高くしても、流動媒体cの移動は増加しなくなる。

したがって、ある範囲内であれば流動層高を高くすることで、循環量を増加させることが可能である。運転中に、循環量を調整したいときに、室RQ、室Rp 内に流動媒体 c を供給して、流動層高を高くして、循環量を増加させたり、流動媒体 c を室RQ、室Rpから抜き出して、流動層高を低くして、循環量を低下させたりすることが可能である。

次に、図6を参照して、流動層高の測定の方法について説明する。図に示すように、沈降チャー燃焼室4には二つの圧力測定装置91、92が、沈降チャー燃焼室4の流動層中の上下2点(水平位置は同じが望ましい)の流動層圧力を測定するよう設置されている。圧力測定装置91、92によって圧力を測定することにより、流動層高を算出し、循環量の制御を行うことができる。ただし、流動層高算出のための圧力測定の箇所は沈降チャー燃焼室4でなく、ガス化室1であってもよい。まず、流動層圧力と流動層高の関係について述べる。流動層圧力Pfと流動層高Hfには以下に述べる関係にある。

 $P f = D f \times g a \times H f x + P 0 \cdot \cdot \cdot (2)$ 

ここに、P f は流動層圧力[Pa]、D f は流動層かさ密度 $[kg/m^3]$ 、g a は重力加速度 $[kg/s^2]$ 、H f x は上方に存在する流動層高[m]、P 0 はフリーボードにおける圧力[Pa]である。

20

(2) 式から、炉底部 B 4 a に近い測定点における流動層圧力を P f 1、上方の流動層高を H f x 1 とすれば、

 $P f 1 = D f 4 a \times g a \times H f x 1 + P 0 \cdot \cdot \cdot (2)$ 

炉底部 B 4 a から遠い測定点における流動層圧力を P f 2 、上方の流動層高を 5 H f x 2 とすれば、

 $P f 2 = D f 4 a \times g a \times H f x 2 + P 0 \cdot \cdot \cdot (2)$  "

となる。ここで、測定点間距離を  $\Delta$  H f (既知)とすると、  $\Delta$  H f = H f x 1 - H f x 2 である。流動層圧力を表す両式 (2) 、 (2) の差を取ると、

Pf1-Pf2=Df4a×ga× $\Delta$ Hf・・・(3) となる。

- 10 以下のステップにより、流動層高を算出することができる。まず、流動層中の上下 2点(水平位置は同じが望ましい)での各々の流動層圧力 P f 1、 P f 2を 測定し、各流動層圧力の圧力差 Δ P (= P f 1 - P f 2)を計算する。次に、
- (3) 式から流動層かさ密度Df4aを計算する(上下2点間の高さ $\Delta$ Hfは既知)。どちらかの測定点の流動層圧力(測定層高さは既知であり、また炉底部B4aに近いほうを選択することが望ましい)の値と、フリーボードでの圧力はほとんど0であるので、P0=0から、(2) 、式を用いて、流動層圧力測定点から流動層上面までの高さHfx1を計算する。流動層高をHf、炉底部B4aに近い測定点の高さをHf1 (既知)とすれば、Hf=Hf1+Hfx1となり、この式から流動層高さHfを計算する。
- 20 圧力測定装置 9 1、 9 2 を設け、流動層圧力 P f 1、 P f 2 を測定し、圧力測定装置 9 1、 9 2 から測定値に基づく圧力信号を演算器としての制御装置 6 に送り、制御装置 6 によって流動層高 H f を演算することができる。このように演算した流動層高 H f を制御装置 6 でコントロールすることで、循環量の制御を行うことができる。制御装置 6 は、演算した流動層高 H f を表す流動層高信号を出力25 するようにしてもよい。

圧力測定装置 9 1 , 9 2 は、流動化が緩慢で、圧力変動が小さい、沈降チャー燃焼室 4 、ガス化室 1 の弱流動化域 1 a 、チャー燃焼室本体部 5 の弱流動化域 2 a に設置することが望ましいが、ガス化室 1 の強流動化域 1 b 、チャー燃焼室本体部 5 の強流動化域 2 b に設置してもよい。流動層高を変化させることで、循

環量を制御できる。流動層高を変化させるためには、流動層高を増加させる場合は流動媒体を供給し、流動層高を減少させる場合は流動媒体を抜き出す。よって、流動層高を変化させるためには、流動媒体を供給する流動媒体供給装置を設け流動媒体を供給し、流動媒体を抜き出す流動媒体抜出装置を設け流動媒体を抜き出せばよい。

図22に示すように、流動媒体供給装置111は、流動媒体cを貯留する流動 媒体貯留装置112と、流動媒体cの流動媒体貯留装置112からの流動媒体 cの供給量を測定し、当該供給量を表す流動媒体供給量信号i21を出力する 流動媒体供給量加定装置113と、流動媒体cの流動媒体貯留装置112内の 流動媒体貯留槽からの供給量を制御する流動媒体供給量制御装置114とを含 んで構成される。

流動媒体供給最初改装置114は、例えば流動媒体貯留装置112から流動媒体を自由落下させて例えばガス化室1に搬送するライン115に設置されると共に流動媒体での供給量を制御する制御弁である。流動媒体供給量測定装置113は、例えば流動媒体貯留装置112内の流動媒体貯留槽の重量の経時変化を測定し、測定した経時変化から流動媒体供給量を求めるものである。

流動媒体供給量制御装置114 (例えば前述の制御弁)は、流動媒体供給量測定装置113からの流動媒体供給量信号i21と制御装置6 (図1)からの後述の流動媒体循環低信号を受け、流動媒体供給量を制御する。

20 流動媒体抜出装置116は、例えばガス化室1の炉底に設けられた流動媒体抜出管117と流動媒体搬送装置118(スクリューコンベヤ、エプロンコンベヤなど)とを含んで構成される。流層媒体抜出装置116により抜き出され搬送された流動媒体 c は、前述の流動媒体貯留装置112に供給され貯留される。流動媒体抜出量制御装置119(例えばスクリューコンベヤのオンオフスイッチ、あるいは、スクリューコンベヤの回転数制御装置)は、流動媒体抜出量測定装置120からの流動媒体抜出信号i22と制御装置6(図1)からの後述の循環量信号を受け、流動媒体抜出装置116へ流動媒体抜出装置駆動信号i23を送り流動媒体抜出量を制御する。ここで、本実施の形態では、流動媒体

供給量測定装置113と流動媒体抜出量測定装置120は同一物であり、例えば流動媒体貯留装置112内の流動媒体貯留槽の重量の経時変化を測定し、測定した経時変化から流動媒体抜出量を求めるものである。流動媒体抜出量測定装置120を、流動媒体供給量測定装置113と別のものとし、流動媒体搬送装置118によって搬送される流動媒体cの搬送量を抜出量として直接計測するものであってもよい。

次に図6を参照して循環量の測定方法について、説明する。

沈降チャー燃焼室4のように、流動媒体cの沈降流がある流動層における流動化ガスの圧力損失は、沈降流のない流動層における流動化ガスの圧力損失に比べて、大きくなる。この理由は、流動化ガスは上昇流であるため、流動媒体の沈降流と逆行することから、流動化ガスの抵抗が大きくなるためである。流動層中の高さの異なる上下二点(水平位置は同じが望ましい)間において、流動化ガスの圧力損失を考える。流動媒体の沈降流がない場合の流動化ガスの抵抗をPnとし、流動媒体の沈降流がある場合の流動化ガスの抵抗をPdとすると、両者の差Pd
15 ーPnは、流動媒体の沈降流が速いほど、大きくなる。この現象を利用することで、流動媒体の沈降流の速度を測定することができ、その結果から、流動媒体のの沈降流の速度を測定することができ、その結果から、流動媒体にの循環量を測定することができる。

すなわち、以下の現象を利用して循環量を測定することができる。(1)循環量が大きいほど、流動媒体沈降流の速度は速くなる。(2)流動媒体沈降流の速度が早いほど、流動化ガスの圧力損失は大きくなる。(3)流動化ガス速度 V g が速いほど、流動化ガスの圧力損失は大きくなる。

例えば、沈降チャー燃焼室4においては、以下の式を用いて、循環量を測定することができる。

(循環量) [kg/s] = (流動層かさ密度) [kg/m³]×(流動媒体沈降速度) [m/25 s])×(沈降チャー燃焼室断面積) [m²]・・・①

(流動媒体沈降速度)  $= \alpha \times F1$  (Pd-Pn)  $\times F2$  (Vg) ・・・② (Pd-Pn) の関数であるF1、Vgの関数であるF2については、例えば、以下のように表すことができる。

 $F 1 (P d - P n) = a 0 + a 1 \times (P d - P n) + a 2 \times (P d - P n)^{2}$ 

$$+ a 3 \times (P d - P n)^{3} + \cdots 3$$

あるいは、

 $F 1 (P d - P n) = \beta (P d - P n) \cdot \cdot \cdot \cdot \textcircled{4}$ 

 $F 2 (V g) = b 0 + b 1 \times V g + b 2 \times V g^{2} + b 3 \times V g^{3} + \cdot \cdot \cdot \cdot \odot$ 

5 あるいは、

 $F 2 (Vg) = \xi Vg^{\epsilon} \cdot \cdot \cdot \cdot \oplus$ 

ここで、 $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 、 $\xi$ 、 $\xi$ 、a0、a1、a2、a3、 $\cdots$ 、b0、b1、b2、b3、 $\cdots$ はガス化炉101の形状により決まる定数である。③式および⑤式において、3次近似の式としているが、それぞれ1次近似、2次近似としてもよい。

10 ここで、沈降流がない場合の上下二点間の圧力差 P f 1 - P f 2 は、 P f 1 - P f 2 = P n、沈降流がある場合の上下二点間の圧力差 P f 1 - P f 2 は、 P f 1 - P f 2 = P d、である。沈降流がない状態を例えば試運転段階で各種条件下で発生させ、上下二点間の圧力を測定し、測定したデータを制御装置 6 (図1)に送り、沈降流がない場合の上下二点間の圧力差 P n を制御装置 6 に計算させて記憶させておく。ガス化炉101の実際の生成ガスの製造運転時に沈降流がある場合の上下二点間の圧力を測定し、測定したデータを制御装置 6 に送り、沈降流がある場合の上下二点間の圧力差 P d を制御装置 6 に計算させて、さらに(P d - P n)を制御装置 6 に計算させる。

沈降チャー燃焼室4(図1)へ供給する流動化ガスg4(図1)の流量は、流 20 量測定器75(図1)によって側定され、流量信号i2(図1)が制御装置6に 送られるので、制御装置6は、沈降チャー燃焼室4の流動化ガス速度Vg(Vg 4)を計算することができる。

よって、制御装置6に、式⑤(または式⑥)にVgを代入しF2を求め、式③ (または式④)に(Pd-Pn)を代入しF1を求め、式②にF1、F2を代入 して流動媒体沈降速度を求める。このように求めた流動媒体沈降速度と、前述の (3) 式から求めた流動層かさ密度を、①式に代入し、αは既知(試運転時等に 経験的に求めておくことができる)であることから、循環量を求めることができる。このようにして求められた循環量を用いて、循環量の制御を行うことができる。すなわち、求めた循環量が適切な値になるように、沈降チャー燃焼室4の流

動化ガス量を制御することで、ガス化室層温、および、ガス化室出口ガス組成を コントロールすることができる。制御装置 6 は、流動媒体の循環量を表す流動媒 体循環量信号を出力するようにしてもよい。

以上説明したように、沈降チャー燃焼室4の流動層中の上下2点の流動層圧力 を測定するための圧力測定装置91、92と、沈降チャー燃焼室4の流動化ガスg4の流量測定装置(流量測定器)75(図1)と、上下2点の流動層圧力 の差と流動化ガス量から循環量を計算するための演算装置としての制御装置6 を設けるので、循環量を測定することができる。

前述の原理により、沈降チャー燃焼室4の流動化ガス量は、循環量制御の操作 0 因子である。したがって、循環量を制御するために、沈降チャー燃焼室4の流動化ガス流量を変化させるための流量制御弁(調節弁)65(図1)を設けているので、循環量制御を行うことができる。

これまでに述べた流動層高の測定と循環量の測定とを組み合わせて、循環量の制御をおこなうことができる。

15 循環量の制御は以下のように行う。まず流動層高の測定を行う(ステップ1)。流動層高の測定を行うためには、流動層中の2点間に設置された各圧力測定装置91、92によって各点の流動層圧力を測定する。流動層圧力の測定値が流動層高を計算するための演算装置としての制御装置6に入力され、そこで、流動層高が計算される。計算された流動層高は、循環量制御のための制御装置6に入力される(制御装置6内で20 データのやりとりを行う)。

次に循環量の測定を行う(ステップ2)。

沈降チャー燃焼室4の流動層中の2点間に設置された圧力測定装置91、92による 測定値と、沈降チャー燃焼室4の流動化ガス流量測定のために設置された流量測定 装置75の測定値が、循環量を計算する計算するための演算装置としての制御装置6 に入力され、制御装置6で、循環量が計算される。計算された循環量は、循環量制御 のための制御装置6に入力される(制御装置6内でデータのやりとりを行う)。

次に循環量の制御を行う(ステップ3)。

例えばある時点で、Wpの循環量であるものを Wsの循環量に制御する場合、ステ

ップ2で計算された循環量の測定値 Wpに対応する信号と、設定したい循環量である Wsに対応する信号が制御装置6に送られる。もし、Ws < Wpならば、制御装置6は、流動層高を上げる信号を、流動媒体供給量制御装置114(図22)に送り、Ws > Wpならば、制御装置6は、流動層高を下げる信号を、流動媒体抜出装置118(図22) に送る。

流動媒体供給量制御装置114(図22)が、流動層高を上げる信号を受け取ったとき、 流動媒体供給量制御装置114は、流動媒体供給量を増やすために、例えば制御弁 開度を開ける信号を制御弁に送る。その結果、制御弁の開度が開くことにより、流動 媒体が炉内に供給されて、流動層高が増加し、循環量が増加する。また、流動媒体供 給量制御装置114は、流動媒体供給量測定装置113(図22)からも信号を受け取り、 急激に流動媒体が炉内に供給されないように、流動媒体供給量を定める動作も行う (流動媒体貯留装置112(図22)の流動媒体貯留層に貯留された流動媒体は、炉内 温度より低いため、流動媒体の急激な供給により炉内温度が下がり過ぎないようにす る)。

15 流動媒体抜出量制御装置119(図22)が、流動層高を下げる信号を受け取ったら、 流動媒体供給量を減らすために、例えば流動媒体抜出しのためのスクリューコンベヤ 118(図22)にスイッチオンの信号を送るか、あるいは、スクリューコンベヤの回転数 をあげる信号を送る。その結果、スクリューコンベヤが作動するか、あるいは、スクリュ ーコンベヤの回転数が増加するなどして、その結果、流動媒体抜出管117(図22)を 20 介して、流動媒体が炉内から抜出されて、流動層高が減少し、循環量が減少する。

上記の構成によって、流動層高を変化させて循環量を制御することが可能になる。 次に、図1を参照して説明する。本発明における統合型ガス化炉101では、 上部に開口部を有する仕切壁14によって仕切られたチャー燃焼室本体部5と沈 降チャー燃焼室4(上部に開口部Pxを有する仕切壁Xで仕切られた室Aと室B に相当(図2(a)参照))との間の流動媒体cの移動と、下部に開口部21を 有する仕切壁11によって仕切られたガス化室1とチャー燃焼室本体部5(下部 に開口部Qyを有する仕切壁Yで仕切られた室Aと室Bに相当(図2(b)参 照))間の流動媒体cの移動、下部に開口部25を有する仕切壁15によって仕

切られた沈降チャー燃焼室4とガス化室1(下部に開口部Qyを有する仕切壁Yで仕切られた室Aと室Bに相当(図2(b)参照))間の流動媒体cの移動、上部の開口部と下部の開口部22とを有する仕切壁12によって仕切られた熱回収室3とチャー燃焼室本体部5(上部の開口部Pzと下部の開口部Qzを有する仕切壁Zで仕切られた室Aと室Bに相当(図2(c)参照))間との流動媒体cの移動を適宜組み合わせることによって、隣接する室間の流動媒体cの移動を連続的に行い、かつその移動量を調節することが可能なように構成されている。

ガス化室1の内部で沈降チャー燃焼室4との間の仕切壁15に接する面寄りには、沈降チャー燃焼室4の弱い流動化状態が維持される弱流動化域4aの流動化状態と比べて強い流動化状態が維持される区画としての強流動化域1bが配置されている。全体としては投入された燃料と流動媒体cの混合拡散が促進されるように、場所によって流動化ガスの空塔速度を変化させるのが良く、一例として図2に示したように、強流動化域1bの他に弱い流動化状態が維持される区画としての弱流動化域1aを設けて旋回流を形成させるようにする。強流動化域1b、と弱流動化領域1aでは、流動化ガスg1はそれぞれ領域の全体に渡って均一の流動化速度を有する。

チャー燃焼室本体部 5 は中央部に弱い流動化状態が維持される区画としての弱流動化域 2 a、周辺部に強い流動化状態が維持される区画としての強流動化域 2 bを有し、流動媒体 c およびチャートが内部旋回流を形成している。強流動化域 2 b、と弱流動化領域 2 a では、流動化ガス g 2 はそれぞれ領域の全体に渡って均一の流動化速度を有する。ガス化室 1、チャー燃焼室本体部 5 内の強流動化域 2 bの流動化速度は 5 Umf以上、弱流動化域 2 a の流動化速度は 5 Umf以下とするのが好適であるが、弱流動化域 2 a と強流動化域 2 b に相対的な明確な流動化速度の差を設ければ、この範囲を超えても特に差し支えはない。チャー燃焼室本体部 5 内の熱回収室 3、および沈降チャー燃焼室 4 に接する部分には強流動化域 2 b を配するようにするのがよい。また、熱回収室 3 内には弱流動化域 3 a、沈降チャー燃焼室 4 内には弱流動化域 4 a を配する。弱流動化域 3 a、と弱流動化域 4 a では、流動化ガス g 3、 g 4 は、それぞれ領域の全体に渡って均一の流動化速度を有する。また必要に応じて炉底には弱流動化域側から強流動化域側

20

に下るような勾配を設けるのがよい(不図示)。

このように、チャー燃焼室本体部 5 と熱回収室 3 との仕切壁 1 2 近傍のチャー燃焼室本体部 5 側の流動化状態を熱回収室 3 側の流動化状態よりも相対的に強い流動化状態に保つことによって、流動媒体 c は仕切壁 1 2 の流動床の界面近傍に 5 ある上端を越えてチャー燃焼室本体部 5 側から熱回収室 3 側に流入し、流入した流動媒体 c は熱回収室 3 内の相対的に弱い流動化状態即ち高密度状態のために下方 (炉底方向)に移動し、仕切壁 1 2 の炉底近傍にある下端 (の開口部 2 2)をくぐって熱回収室 3 側からチャー燃焼室本体部 5 側に移動する。流動媒体 c が開口部 2 2 をくぐって熱回収室 3 側からチャー燃焼室本体部 5 側に移動するのは、チャー燃焼室本体部 5 の強流動化域 2 b の開口部 2 2 近傍の流動媒体 c の流動化状態と、熱回収室 3 の弱流動化域 3 a の開口部 2 2 近傍の流動媒体 c の流動化状態と、熱回収室 3 の弱流動化域 3 a の開口部 2 2 近傍の流動媒体 c の流動化状態と、性較すると、前者の方が後者よりも強いからである。

同様に、チャー燃焼室本体部5と沈降チャー燃焼室4との仕切壁14近傍のチャー燃焼室本体部5側の流動化状態を沈降チャー燃焼室4側の流動化状態よりも相対的に強い流動化状態に保つことによって、流動媒体cは仕切壁14の流動床の界面近傍にある上端を越えてチャー燃焼室本体部5の側から沈降チャー燃焼室4の側に移動流入する。沈降チャー燃焼室4の側に流入した流動媒体cは、沈降チャー燃焼室4内の相対的に弱い流動化状態即ち高密度状態のために下方(炉底方向)に移動し、仕切壁15の炉底近傍にある下端(の開口部25)をくぐって沈降チャー燃焼室4側からガス化室1側に移動する。なおここで、ガス化室1の強流動化域1bの開口部25近傍の流動媒体cの流動化状態と、沈降チャー燃焼室4の弱流動化域4aの開口部25近傍の流動媒体cの流動化状態とを比較すると、前者の方が後者よりも強い。これにより流動媒体cの沈降チャー燃焼室4からガス化室1への移動を誘引作用により助ける。

25 同様に、ガス化室1とチャー燃焼室本体部5との間の仕切壁11近傍のチャー燃焼室本体部5側の流動化状態はガス化室1側の流動化状態よりも相対的に強い流動化状態に保たれている。したがって、流動媒体cは仕切壁11の流動床の界面より下方、好ましくは濃厚層の上面よりも下方にある(濃厚層に潜った)開口部21を通してチャー燃焼室本体部5の側に流入する。流動媒体cが開口部21

を通ってガス化室1側からチャー燃焼室本体部5側に移動するのは、チャー燃焼室本体部5の強流動化域2bの開口部21近傍の流動媒体cの流動化状態と、ガス化室1の弱流動化域1aの開口部21近傍の流動媒体cの流動化状態とを比較すると、前者の方が後者よりも強いからである。

5 前述のように熱回収室 3 は全体が均等に流動化され、通常は最大でも熱回収室 3 に接したチャー燃焼室本体部 5 の流動化状態より弱い流動化状態となるように 維持される。したがって、熱回収室 3 の流動化ガス g 3 の空塔速度は 0 ~ 3 Umf の間で制御され、流動媒体 c は緩やかに流動しながら沈降流動層を形成する。な おここで 0 Umf とは、流動化ガス g 3 が止まった状態である。このような状態 10 にすれば、熱回収室 3 での熱回収を最小にすることができる。即ち、熱回収室 3 は流動媒体 c の流動化状態を変化させることによって回収熱量を最大から最小の 範囲で任意に調節することができる。また、熱回収室 3 では、流動化を室全体で一様に発停あるいは強弱を調節してもよいが、その一部の領域の流動化を停止し 他を流動化状態に置くこともできるし、その一部の領域の流動化状態の流動の強 3 弱を調節してもよい。

さらに図1を参照し、ガス化室1とチャー燃焼室本体部5の間の流動媒体cの循環量を調節する方法について、以下において具体的に説明する。

ガス化室1とチャー燃焼室本体部5とを仕切る仕切壁11の下端に設けられた 開口部21のガス化室1側に配置された弱流動化域1aの流動化ガス速度を変化 させることにより、開口部21を介したガス化室1からチャー燃焼室本体部5へ の流動媒体cの移動量を増加させた場合を考える。この場合、開口部21を介し たガス化室1からチャー燃焼室本体部5への流動媒体cの移動量がまず増加する ことにより、チャー燃焼室本体部5の流動層高の上昇と、ガス化室1の流動層高 の低下が一時的に起こる。

25 前述したように、このような流動層高の変化により、開口部21を介した流動 媒体 c の移動は抑えられる方向に作用し、ある状態でバランスすることになる。 一方では、チャー燃焼室本体部5の流動層高の上昇は、チャー燃焼室本体部5か ら沈降チャー燃焼室4へ仕切壁14を越えて飛び込む流動媒体 c の飛び込み量の 増加をもたらす。これにより、沈降チャー燃焼室4の炉底部の圧力は上昇し、一

10

15

20

方ではガス化室1の流動層高の低下により、ガス化室1の炉底部の圧力は低下する。

このため、ガス化室1と沈降チャー燃焼室4とを仕切る仕切壁15の下端に設けられた開口部25に注目すると、沈降チャー燃焼室4側の圧力は上昇し、ガス化室1側の圧力は低下するから、その圧力差を駆動力として、開口部25を介した沈降チャー燃焼室4からガス化室1への流動媒体cの移動量が増加する。

このように、最初に与えたガス化室1からチャー燃焼室本体部5への流動媒体 c の移動量の増加により、流動層高の変化が生じて、そのためにガス化室1からチャー燃焼室本体部5への流動媒体 c の移動量増加が若干打ち消され、またチャー燃焼室本体部5から沈降チャー燃焼室4を経由してガス化室1に至る流動媒体 c の移動量が増加するような作用がもたらされる。この機構により、最終的にはガス化室1とチャー燃焼室本体部5との間の流動媒体 c の粒子移動量が釣り合うようにガス化室1とチャー燃焼室本体部5との流動層高が変化して安定するが、安定した状態での粒子移動量は、最初の状態より増加した状態に保たれることになる。

即ち、ガス化室1とチャー燃焼室本体部5との間の流動媒体 c の循環量を調節するためには、ガス化室1からチャー燃焼室本体部5への流動媒体 c の移動量を変化させてもよい。また、チャー燃焼室本体部5からガス化室1への流動媒体 c の移動量を変化させてもよいし、あるいはその両者を変化させるようにしてもよいが、実際上は各室の流動層高が変化することにより、どちらか一方の移動量を変化させる操作を行うだけで、ガス化室1からチャー燃焼室本体部5への流動媒体 c の移動量と、チャー燃焼室本体部5からガス化室1への流動媒体 c の移動量が釣り合うような状態で安定させることが可能である。

したがって、ガス化室1とチャー燃焼室本体部5との間の流動媒体 c の移動量 を調節するためには、前述のように開口部21を介したガス化室1からチャー燃焼室本体部5への流動媒体 c の移動量を調節してもよいし、または仕切壁14の上端を超えてのチャー燃焼室本体部5から沈降チャー燃焼室4への流動媒体 c の移動量を調節してもよいし、あるいは開口部25を介した沈降チャー燃焼室4からガス化室1への流動媒体 c の移動量を調節してもよい。

ここで、いずれの方法の場合においても、流動媒体 c の移動量の調節は、炉底部から供給される流動化ガスgの量を変化させることによって行われるが、ガス化炉101の機能を確保するためには、流動化ガスgの供給量を変化させたことにより、ガス化室1で行われる燃料のガス化反応、チャー燃焼室本体部5で行われるチャーの燃焼反応が影響を受けないようにすることが望ましい。即ち、ガス化室1に供給される流動化ガスg1の総量、あるいはチャー燃焼室本体部5に供給される流動化ガスg2の総量が変化しないようにすることが望ましい。

例えば、ガス化室1の開口部21の近く弱流動化域1aの流動化ガスg1の供給量を減少させ、チャー燃焼室本体部5の開口部21の近傍の強流動化域2bの流動化ガスg2の供給量を増加させることで、開口部21を介したガス化室1からチャー燃焼室本体部5への流動媒体cの移動量を増加させるように調節する場合、ガス化室1の隅口部21の強流動化域1bへの流動化ガスg1の供給量を増加させ、チャーで原金本体部5の開口部21の弱流動化域2aの流動化ガスg2の供給量を減少させることで、ガス化室1とチャー燃焼室本体部5の各々に供給される各々の流動化ガスg1、g2の供給量を加えた総量が変化しないような操作を行うことが望ましい。

また、チャー燃焼室本体部5の仕切壁14の近くの強流動化域2bの流動化ガスg2の供給量を増加させ、チャー燃焼室本体部5から沈降チャー燃焼室4へ仕切壁14を越えて飛び込む流動媒体cの飛び込み量を増加させることで、チャー燃焼室本体部5から沈降チャー燃焼室4への流動媒体cの移動量を増加させるように調節する場合、チャー燃焼室本体部5の仕切壁14から離れた弱流動化域2aへの流動化ガスg2の供給量を減少させることで、チャー燃焼室本体部5に供給される流動化ガスg2の総量が変化しないような操作を行うことが望ましい。

これに対して、開口部25を介した、沈降チャー燃焼室4からガス化室1への 流動媒体cの移動量を調節する場合は、ガス化室1あるいはチャー燃焼室本体部 5への流動化ガスg1、g2の供給量を変化させることなく、沈降チャー燃焼室 4への流動化ガスg4の供給量を変化させるのみで流動媒体cの移動量を調節す ることができるので、特に好適である。

この場合、ガス化室1側の開口部25寄りは強流動化域1bであるので強流動

化状態に保たれ、沈降チャー燃焼室4側は区画としての弱流動化域4aであるので弱流動化状態に保たれているから、ガス化室1側の強流動化域1bの強流動化状態を一定に保ったまま、沈降チャー燃焼室4側の弱流動化状態の強弱を変化させることによって、効果的に沈降チャー燃焼室4からガス化室1への流動媒体 c の移動量を調節することができる。

既に説明したように、開口部25のガス化室1側の近傍の強流動化域1bは、強流動化状態に保たれていることが望ましく、流動化ガス速度が好ましくは4Umf以上、さらに好ましくは5Umf以上に保たれているのがよい。この場合、沈降チャー燃焼室4の流動化ガス速度を、4Umf以下の範囲(強流動化域1bの流動化ガスの流速が4Umf以上の場合)または5Umf以下の範囲(強流動化域1bの流動化ガスの流速が5Umf以上の場合)で変化させることにより、沈降チャー燃焼室4からガス化室1への流動媒体cの移動量を、図4によって示される特性に従って調節することができる。

なお図4によれば、特に沈降チャー燃焼室4側の流動化ガス速度を、好ましくは $1Umf \sim 2Umf$ の範囲、さらに好ましくは $1Umf \sim 1.7Umf$ の範囲で変化させた場合に、流動媒体 c の移動量がほぼ線形的に大きく変化することがわかる。この場合、沈降チャー燃焼室4に供給される流動化ガスg 4の量を少なくして、かつ流動媒体 c の移動量を細かく調節することができるため、特に好適である。

もちろんこれとは逆に、沈降チャー燃焼室4の弱流動化の状態を一定として、 ガス化室1の強流動化の状態を変化させて、沈降チャー燃焼室4からガス化室1 への流動媒体cの移動量を変化させることも可能ではある。しかし、その場合に は流動媒体cの移動量を変化させるための流動化ガスg1の流量の変化が大きく なり、ガス化室1におけるガス化反応の条件も変わってしまうため好適ではない。 すなわち、後で述べるように、実用上はガス化室1の層温を変化させることが生 成ガスbの性状を制御する上で非常に重要であるが、ガス化室1の強流動化の状態を変化させる場合は、層温の変化に付随してガス化室1の反応条件も変わって しまい、ガス化室1の層温だけを独立に制御することが難しくなる。これに対し て、上記で説明した沈降チャー燃焼室4の弱流動化の状態を変化させることによ る流動媒体cの移動量の制御の場合は、流動化ガスg4の流量の変化が非常に少

5

10

20

25

なくても流動媒体 c の移動量の大きな変化を実現することができるため(図 4 参照)、制御性が良い、プロセス全体の効率に与える影響が少ないなどの利点に加えて、ガス化室 1 に供給する流動化ガス g 1 の流量を変えずにガス化室 1 の層温のを制御することができるという大きな利点がある。

次に図1を参照して流動化ガスgのガス速度の制御について説明する。まず、ガス化室1に供給される流動化ガスg1のガス速度の制御について説明する。前述のように、ガス化室1の弱流動化域1aに対応する炉底に配置された散気装置31に接続された供給配管51に設置された調節弁61は、制御装置6からの制御信号i1を受けて弁開度を設定する。弁開度に対応した流量の流動化ガスg1が調節弁61を介して散気装置31に供給される。供給される流動化ガスの流量によって決まる流動化ガス速度で弱流動化域1aに流動化ガスg1が供給される。流動化ガスg1の流量は、供給配管51上の調節弁61の下流側に設置された流量測定器71によって測定され、測定された流量は流量信号i2として流量測定器71から制御装置6に送られる。制御装置6は、測定された流量信号i2と内部に記憶された弱流動化域1aの目標流量と比較し、流量信号i2と内部に記憶された弱流動化域1aの目標流量と比較し、流量信号i2が目標値に近づくように調節弁61への制御信号i1の値を変更し、変更された制御信号i1が制御装置6から調節弁61に送られる。

以上、ガス化室1の弱流動化域1 a の流動化ガスg 1 のガス速度の制御について説明したが、ガス化室1 の強流動化域1 b、チャー燃焼室2 の弱流動化域2 a、強流動化域2 b、弱流動化域4 a、熱回収室3 の弱流動化域3 a についても同様である。

ガス化室1の弱流動化域1 a に供給される流動化ガスg1の流量の目標値、強流動化域1 b に供給される流動化ガスg1の流量の目標値は、目標とするガス化室1内部での流動化状態の強さ、ガス化室1の弱流動化域1 a から開口部21を介してチャー燃焼室本体部5の弱流動化域1 a へ移動する流動媒体 c の移動量、 沈降チャー燃焼室4 からガス化室1 の強流動化域1 b へ移動する流動媒体 c の移動量、温度測定器42によって測定されたガス化室1 の層温、ガス組成測定器46により測定された生成ガスbのガス組成を総合的に勘案し、ガス化室1 の層温が所定の値(例えば、600~800℃)になるように、あるいはガス組成が所

定の内容 (例えば、H₂/C O モル比が 2.6~5.8) になるように決めるとよい。

チャー燃焼室2の弱流動化域2aに供給される流動化ガスg2の流量の目標値、強流動化域2bに供給される流動化ガスg2の流量の目標値は、沈降チャー燃焼室本体部5内部での流動化ガスg4の流量の目標値は、目標とするチャー燃焼室本体部5内部での流動化状態の強さ、目標とする沈降チャー燃焼室4での流動化状態の強さ、チャー燃焼室本体部5の強流動化域2bから仕切壁14の上端を越えて沈降チャー燃焼室4に移動する流動媒体cの移動量、沈降チャー燃焼室4から開口部25を介してガス化室1の強流動化域2bへ移動する流動媒体cの移動量、割回収室3から開口部22を介してチャー燃焼室本体部5の強流動化域2bへ移動する流動媒体cの移動量、チャー燃焼室本体部5の強流動化域2bから仕切壁12の上端を超えて終回収室3に移動する流動媒体cの移動量、温度測定器43によって測定されたチャー燃焼室本体部5の層温を総合的に勘案し、チャー燃焼室本体部5の層温を総合的に勘案し、チャー燃焼室本体部5の層温を総合的に勘案し、チャー燃焼室本体部5の層温を総合的に勘案し、チャー燃焼室本体部5の層温を総合的に勘案し、チャー燃焼室本体部5の層温を総合的に勘案し、チャー燃焼室本体部5の層温を総合的に勘案し、チャー燃焼

熱回収室3を行する場合、チャー燃焼室本体部5の層温は、熱回収室3で回収 される熱回収量の影響を受け、熱回収量が増えればチャー燃焼室本体部5の層温 は低下し、熱回収量が減ればチャー燃焼室本体部5の層温は増加する。

20 次に熱回収室3で、熱回収量を増減するための制御の方法について説明する。 熱回収室3における熱回収量は、流動媒体 c と層内伝熱管41Aとの間の熱伝達 係数によって決まる。この熱伝達係数は、熱回収室3における流動化の強弱に密 接な関係があり、流動化が強いほど熱伝達係数が大きくなり、層内伝熱管が流動 媒体から熱を奪う量が増加する。したがって、チャー燃焼室本体部5の層温を一 定に保つためには、熱回収室3の流動層に供給される流動化ガスg3の流量を制 御することにより、熱回収室3における流動化の強弱を変化させればよい。

熱回収室3に供給される流動化ガスg3を導入する供給配管56に設置された 調節弁66は、制御装置6からの制御信号i1を受けて弁開度を設定する。弁開 度に対応した流量の流動化ガスg3が調節弁66を介して熱回収室3の流動層に 供給される。流動化ガスg3の流量は調節弁66の下流に設置された流量測定器76によって測定され、測定された流量は制御信号i2として制御装置6に送られる。前述のように、流動化ガスg3の流量が大きいほど熱回収室3の流動化が強くなり、熱回収量が増加するから、チャー燃焼室本体部5の層温が目標値より高い場合には、制御装置6はチャー燃焼室本体部5の層温が目標値に近づくように調節弁66への制御信号i1の値を変更し、流動化ガスg3の流量を増加させるように構成すればよい。またチャー燃焼室本体部5の層温が目標値より低い場合には、制御装置6はチャー燃焼室本体部5の層温が目標値に近づくように調節弁66への制御信号i1の値を変更し、流動化ガスg3の流量を減少させるように構成すればよい。

一方、蒸気については、層内伝熱管 4 1 の導入部 4 1 Bに設置された調節弁 6 7 が、制御装置 6 からの制御信号 i 1 を受けて弁開度を設定する。弁開度に対応した流量の蒸気 s 1 が調節弁 6 7 を介して層内伝熱管本体 4 1 Aに供給される。 層内伝熱管本体 4 1 Aに供給される。 層内伝熱管本体 4 1 Aに導入された蒸気 s 1 は熱回収室 3 の流動化状態によって決まる熱伝達係数に応じた熱量を流動媒体 c から受けて加熱され過熱蒸気 s 2 となり、排出部 4 1 C から排出される。蒸気 s 1 の流量は、導入部 4 1 B 上の調節 并 6 7 の F 流側に設置された流量測定器 7 7 によって測定され、測定された流量は流量信号 i 2 として、流量測定器 7 7 から制御装置 6 に送られる。過熱前の蒸気 s 1 の温度は、導入部 4 1 B に設置された温度測定器 4 4 によって測定され、測定された温度は温度信号 i 3 として制御装置 6 に送られる。過熱後の蒸気 s 2 の温度は、排出部 4 1 C に設置された温度測定器 4 5 によって測定され、測定された温度は温度信号 i 3 として制御装置 6 に送られる。

例えば熱回収室3の流動化の強弱を強めて熱回収量を増加させた場合、層内伝熱管41に供給される蒸気 s 1 の流量が一定に保たれているとすると、得られる過熱蒸気 s 2 の温度が上昇する。過熱蒸気 s 2 の利用形態上、温度が上昇することが好ましくない場合には、供給する蒸気 s 1 の流量を増加させることで、熱回収量の増加を回収される過熱蒸気 s 2 の流量の増加に反映させることができる。この場合、制御装置 6 は、過熱後の蒸気 s 2 の温度信号 i 3 が蒸気 s 2 の目標温度より高い場合には、調節弁 6 7 への制御信号 i 1 の値を変更して蒸気 s 1 の流

10

15

量を増加させるように構成すればよい。逆に過熱後の蒸気 s 2 の温度信号 i 3 が蒸気 s 2 の目標温度より低い場合には、調節弁 6 7 への制御信号 i 1 の値を変更して蒸気 s 1 の流量を減少させるように構成すればよい。

廃棄物または燃料 a 中に含まれる比較的大きな不燃物はガス化室1の炉底に設けた不燃物排出口(不図示)から排出する。また、各室の炉底面は水平でもよいが、流動媒体 c の流れの滞留部を作らないようにするために、炉底近傍の流動媒体 c の流れに従って、炉底を傾斜させてもよい。なお、不燃物排出口(不図示)は、ガス化室1の炉底だけでなく、チャー燃焼室本体部5、沈降チャー燃焼室4あるいは熱回収室3の炉底に設けてもよい。

10 ガス化室1の流動化ガスg1として最も好ましいのは生成ガスbを昇圧してリサイクル使用することである。このようにすればガス化室1から出る生成ガスbは純粋に燃料から発生した生成ガスbのみとなり、非常に高品質の生成ガスbを得ることができる。それが不可能な場合は水蒸気、炭酸ガス(CO2)あるいはチャー燃焼室2から得られる燃焼排ガス等、できるだけ酸素を含まないガス(無酸素ガス)を流動化ガスg1として用いるのがよい。ガス化の際の吸熱反応によって流動媒体cの層温が低下する場合は、必要に応じて熱分解温度より温度の高い燃焼排ガスを供給するか、あるいは無酸素ガスに加えて、酸素もしくは酸素を含むガス、例えば空気を供給して生成ガスbの一部を燃焼させるようにしてもよい。チャー燃焼室2に供給する流動化ガスg2、g4は、チャー燃焼に必要な酸素を含むガス、例えば空気、酸素と蒸気の混合ガスを供給する。燃料aの発熱量(カロリー)が低い場合は、酸素量を多くする方が好ましく、酸素をそのまま供給する。また熱回収室3に供給する流動化ガスg3は、空気、水蒸気、燃焼排ガス等を用いる。

ガス化室1とチャー燃焼室2の流動床の上面(スプラッシュゾーンの上面)より上方の部分即ちフリーボード部は完全に仕切壁11、15で仕切られている。さらに言えば、流動床の濃厚層の上面より上方の部分即ちスプラッシュゾーン及びフリーボード部は完全に仕切壁で仕切られているので、チャー燃焼室2とガス化室1のそれぞれのフリーボード部の圧力のバランスが多少乱れても、双方の流動層の界面の位置の差、あるいは濃厚層の上面の位置の差、即ち流動層高差が多

少変化するだけで乱れを吸収することができる。即ち、ガス化室1とチャー燃焼室2とは、仕切壁11、15で仕切られているので、それぞれの室の圧力が変動しても、この圧力差は流動層高差で吸収でき、どちらかの層が開口部21、25の上端に下降するまで吸収可能である。したがって、流動層高差で吸収できるチャー燃焼室2とガス化室1のフリーボードの圧力差の上限値は、互いを仕切る仕切壁11、15の下部の開口21、25の上端からの、ガス化室流動床のヘッドと、チャー燃焼室流動床のヘッドとのヘッド差にほぼ等しい。

ただし、上記において、圧力バランスの多少の乱れを、流動層高差で吸収する場合、流動層高の変化に応じて、流動媒体 c の各室間の移動量に変化が生じる。したがって、流動媒体 c の各室間の移動量を一定に保つためには、圧力バランスの乱れを最小限に抑える制御機構を付加することが重要となる。

図1を参照して、圧力バランスの乱れを抑えるための制御の方法について、以下で説明する。ガス化室1から排出される生成ガスbと、チャー燃焼室2から排出されるチャー燃焼ガスeは、それぞれ後段に設置された圧力制御用の調節弁78または調節弁79を経由して排出され利用される。

ここで、図1ではガス化室1から、あるいはチャー燃焼室2からガスが排出された直後に調節弁78及び調節弁79が設置されている様に描かれているが、その他の機器を通過した後に調節弁78あるいは調節弁79が設置されていても、調節弁78あるいは調節弁79の開度を調節することにより対応するガス化室1あるいはチャー燃焼室2からのガスの排出の抵抗を変化させ、ガス化室1あるいはチャー燃焼室2の圧力を変化させることができるのであれば構わない。ガス化室1のフリーボード部と、チャー燃焼室2のフリーボード部には、それぞれ圧力測定装置としての圧力測定器81、82が設置されており、各々の室1、2の圧力が検出されて圧力信号i5として制御装置6に送られる。制御装置6は、ガス化室1のフリーボード部の圧力信号i5と、チャー燃焼室2のフリーボード部の圧力信号i5を比較して、その差が流動媒体cの各室間の移動量に影響を及ぼさない一定の範囲内、好ましくは両室1、2の圧力差がガス化室1またはチャー燃焼室2の流動層の圧力損失の±10%以下、さらに好ましくは±5%以下、さらに好ましくは両室1、2の圧力が等しくなるように、制御信号i1を調節弁78

10

15

10

15

あるいは調節弁79に送り、調節弁78あるいは調節弁79の開度を変化させる。以上説明した統合型ガス化炉101では、一つの流動床炉の内部に、ガス化室、1、チャー燃焼室2、熱回収室の3つを、それぞれ隔壁を介して設け、さらにチャー燃焼室2とガス化室1、チャー燃焼室2と熱回収室3はそれぞれ隣接して設けられている。この統合型ガス化炉101は、チャー燃焼室2とガス化室1間に大量の流動媒体 c の循環を可能にしているので、流動媒体 c の顕熱だけでガス化のための熱量を充分に供給できる。

さらに以上の統合型ガス化炉101では、チャー燃焼ガス e と生成ガス b の間のシールが完全にされるので、ガス化室1とチャー燃焼室2の圧力バランス制御がうまくなされ、燃焼ガス e と生成ガス b が混ざることがなく、生成ガス b の性状を低下させることもない。

また、熱媒体としての流動媒体 c とチャートはガス化室1側からチャー燃焼室2側に流入するようになっており、さらに同量の流動媒体 c がチャー燃焼室2側からガス化室1側に戻るように構成されているので、自然にマスバランスがとれ、流動媒体 c をチャー燃焼室2側からガス化室1側に戻すために、コンベヤ等を用いて機械的に搬送する必要もなく、高温粒子のハンドリングの困難さ、顕熱ロスが多いといった問題もない。

次に、図1を参照して統合型ガス化炉101の生成ガスbのガス組成の制御について説明する。

20 本発明では、前述のようにガス化室1とチャー燃焼室2の間の流動媒体cの移動量、即ち内部循環量を調節することにより、ガス化室1及びチャー燃焼室2の流動層温度をそれぞれ実用上任意に制御し、あるいはガス化室1から発生する生成ガスbの組成を変化させることを目的としている。このため、統合型ガス化炉101の運転上は、制御装置6に流動化ガス量に変化を与える指令を出させることになる。即ち、制御装置6から調節弁61~67に流量を制御する制御信号i1が送られ調節弁61~67が流動化ガス流量を調節する。流動化ガス流量が調整されることは流動化ガス速度が調節されることである。流動化ガス速度が調節されることは流動化ガス速度が調節されることである。流動化ガス速度が調節されると内部循環量がどのように調節され、それによってガス化室1及びチャー燃焼室2の流動層温度、さらにはガス化室1から発生する生成ガスbの組成がど

5

10

20

25

のように変化するかを計測し、その結果をもとに流動化ガス量を調節するような、 制御ロジックを制御装置 6 に構成することが好ましい。

例えば、ガス化室1の流動層温度を変化させることを目的として内部循環量を 調節する場合について、以下説明する。

具体的に、沈降チャー燃焼室4の流動化ガス速度が1Umf~2Umf程度の範囲の弱流動化状態にあって、ガス化室1の流動層温度の温度測定器42の測定値が、目標とするガス化室1の流動層温度よりも低い場合を考える。この場合、既に説明したように、沈降チャー燃焼室4の流動化ガス量を1Umf~2Umfの範囲内で増加させることによって沈降チャー燃焼室4の流動層粘性を低下させ(図3参照)、沈降チャー燃焼室4からガス化室1への流動媒体cの移動量を増やすことができる(図4参照)。

先に述べたように、このとき沈降チャー燃焼室4からガス化室1への流動媒体 c の移動量が増えると、ガス化室1の層高が一時的に上昇することにより、ガス 化室1からチャー燃焼室2への流動媒体 c の移動量が増加し、チャー燃焼室2の 層高も若干上昇する。すると、チャー燃焼室2から沈降チャー燃焼室4への流動 媒体 c の飛び込み量も増加し、結果としてガス化室1からチャー燃焼室2、チャー燃焼室2から沈降チャー燃焼室4からガス化室1への全ての流動媒体 c の移動量が初期の状態よりも増加した状態で安定することになる。このとき、ガス化室1とチャー燃焼室2の相互間の流動媒体 c の移動量の増加により、ガス化室1とチャー燃焼室2の温度差は小さくなる。即ちガス化室1の流動層温度は上昇し、チャー燃焼室2の流動層温度は低下することになる。なお以下では、ガス化室1からチャー燃焼室2、チャー燃焼室2から沈降チャー燃焼室4、沈降チャー燃焼室4からガス化室1への全ての流動媒体 c の移動量が同じ値に安定した状態での、ガス化室1とチャー燃焼室2の相互間の流動媒体 c の移動量を「内部循環量」と呼ぶ。

ある一定時間が経過して、ガス化室1の流動層温度が安定した段階において、 その安定した温度が目標とする流動層温度よりもまだ低ければ、沈降チャー燃焼 室4の流動化ガス量をさらに増加させればよい。また、その安定した温度が目標 とする流動層温度よりも高ければ、沈降チャー燃焼室4の流動化ガス量をいくら か減少させればよい。

以上のような操作は、図1に示したような構成により、演算装置を内包する制御装置6に対してガス化室1の流動層温度の測定値と目標値とを入力し、その差分の大小に基づいて沈降チャー燃焼室4への流動化ガスg4の供給量を変化させるように調節弁65への制御信号i1が変化し調節弁65の開度を変化させるよう構成することで、容易に実現することができる。

前述において、弱流動化域 1 a、 2 a、 3 a、 4 a、 強流動化域 1 b、 2 b は、それぞれ一つの調節弁 6 1  $\sim$  6 6 が接続された散気装置 3 1  $\sim$  3 6 を有するとして説明した。

10 しかし、図5 (統合型ガス化炉101の一部を省略) に示すように、例えば、 開口部21を挟む弱流動化域1a、強流動化域2bを、それぞれ開口部21に直 接隣接する近傍域1ax、2bxと、近傍域1ax、2bx以外の遠隔域1ay、 2byとに分離し、散気装置31、34を、それぞれ近傍域1ax、2bxに対 応する近傍部分31x、34xと、遠隔域1ay、2byに対応する遠隔部31 y、34yに分離するように構成してもよい。

散気装置 31、 34の遠隔部 31 y、 34 yに前述の供給配管 51、 54 をそれぞれ接続し、散気装置 31、 34 の近傍部 31 x、 34 x に、流量測定器 71 x、 74 x 及び調節 # 61 x、 64 x が設置 された供給配管 51 x、 54 x を接続するようにしてもよい。開口部 21 を介して流動媒体 c が移動する移動量を制御するために供給される流動化ガス g1、 g2 の速度をそれぞれ弱流動化域 1a x、 2b x から供給される流動化域 2b 全域に渡って制御する代わりに、近傍域 1a x、 2b x から供給される流動化ガス g1、 g2 のガス流速をそれぞれ制御するようにしてもよい。この制御は、前述のように制御装置 6 (図1 参照)により調節 # 61 x、 64 x を制御することにより行う。

25 開口部25を挟む弱流動化域4a、強流動化域1b、開口部22を挟む弱流動化域3a、強流動化域2bも同様に、開口部25、22に直接隣接する不図示の近傍域と近傍域以外の不図示の遠隔域に分離し、開口部25、22を介して流動媒体cが移動する移動量を制御するために供給される流動化ガスの速度をそれぞれ弱流動化域4a、3a、強流動化域1b、2b全域に渡って制御する代わりに、

近傍域から供給される流動化ガスのガス流速をそれぞれ制御するようにしてもよい。

統合型ガス化炉101のある一つの安定した運転状態から内部循環量を変化させた場合に発生する現象、得られる効果について以下で述べる。まず、内部循環量の変化に対応してガス化室1あるいはチャー燃焼室2の層温の変化が生じる。内部循環量を増加させた場合は、ガス化室1の層温は上昇し、チャー燃焼室2の層温は低下する。逆に内部循環量を減少させた場合、ガス化室1の層温は低下し、チャー燃焼室2の層温は上昇する。

また、ガス化室1、チャー燃焼室2ともに、室1、2内の流動媒体cの滞留時 10 間が変化する。例えば、内部循環量を1/2に減らした場合、各室1、2内の流 動媒体cの滞留時間は2倍となる。逆に、内部循環量を2倍に増やした場合、各 室1、2内の流動媒体cの滞留時間は1/2となる。

また、ガス化室1でのチャートの発生量が変化する。例えば、内部循環量を減少させた場合、ガス化室1の層温の低下を反映し、ガス化室1でのチャートの発生量は増加する。一般にチャートの発生量は、層温が低いほど増加する。内部循環量を増加させた場合、ガス化室1の層温の上昇を反映し、チャートの発生量は減少する。一般にチャートの発生量は、ガス化室1の層温が高いほど減少する。

チャーhの発生量の変化とガス化室1の層温の変化を反映して、ガス化室1で生成される生成ガスbのガス組成が変化する。これは、チャーhの発生量(ガス化室1からチャー燃焼室2に移動する可燃分の量)が変化することによる元素バランス(炭素、水素、酸素等のモル比(%))の変化と、温度によるガス成分の平衡状態の変化による。

生成ガス組成の変化により生成ガス b の H 2 / C O 比、ガス発熱量等が変化する。 H 2 / C O 比は、生成ガス b からの水素、液体燃料等の製造効率に関わる重要因子である。ガス発熱量は、生成ガス b を燃焼利用する場合の重要因子である。

以上から、内部循環量を変化させることにより、ガス化室1の層温を実用上任意に制御し、それにより生成ガスbの組成(H₂、CO、CO₂、CH₄、H₂O等のモル%に加え、H2/CO比、ガス発熱量など、生成ガス組成によって決まる因子を含む概念とする。)を変化させることができる。

この場合、例えばガス化室1の層温を下げるように制御すると、対応してチャー燃焼室2の層温は上昇する。逆に、ガス化室1の層温を上げるように制御すると、対応してチャー燃焼室2の層温は低下する。チャー燃焼室の運転温度は、ガス化室1から移動してきたチャートやタール分を完全燃焼するのに最適な温度範囲、好ましくは850~950℃に保つことが好ましいから、内部循環量を変化させることでガス化室1の層温を変化させた場合には、チャー燃焼室2の温度が上記の最適な範囲を外れないように別の方法で調節する必要がある。

そのためには、既に説明したように熱回収室3を有する場合には、熱回収室3における熱回収量を制御することによりチャー燃焼室本体部5の層温を一定に保つように制御を行うことができる。また、用いられる原料の一部を直接にチャー燃焼室へ供給したり、あるいはその供給量を変化させることにより、チャー燃焼室における可燃分の燃焼量を直接に変化させるように制御を行ってもよい。また、チャー燃焼室2の温度が非常に高くなってしまう場合には、流動層部に水を供給したり、あるいはその供給量を変化させることにより直接に流動層の温度を冷却するような制御を行ってもよい。

以下に、統合型ガス化炉101(図1)を想定した試算結果の一例を示す(図1 1、図13~図15)。原料αは、木質系バイオマス、ガス化室1は200℃の 蒸気によりガス化し、チャー燃焼室2は、空気によりチャートを燃焼するものと した。チャー燃焼室2の層温は、熱回収室3の熱回収量の制御によって900℃ で一定に保ち、内部循環量を変化させた場合に、ガス化室1の層温がどう変わる か、それに伴って生成ガストの組成や発熱量がどう変わるかを試算した。なお、 内部循環量については、媒体粒子の循環量(kg/h)を原料αの投入量(kg/h)で除した無次元数(以下「循環比」という)によって整理してある。

図11に、ケース1の内部循環量(循環比)とガス化室層温(単位℃)の関係を示し、図12にケース2の内部循環量(循環比)とガス化室層温(単位℃)の関係を示す。図11、図12は、計算結果である。ガス化炉1のスケール、原料a、プロセス条件(流動化蒸気、空気など)により、低下するガス化室層温の絶対値は異なるが、図11および、図12に示すように、内部循環量(循環比)を減少させるほど、ガス化室1の層温は低下し、内部循環量(循環比)を増加させるほ

ど、ガス化室1の層温は上昇する。例えば、図11(ケース1)では、ガス化室1の層温を800℃に保つための内部循環量を基準として、700℃に保つための内部循環量は約44%(20/45)、600℃に保つための循環量は約22%(10/45)となる。以上から、ガス化室1の層温を600~800℃の範囲で制御可能とするためには、流動媒体 c の内部循環量は、最大値から最大値の20%程度の範囲で実用上任意に変化させることができるように構成することが好ましい。典型的には、ガス化室1の層温が一定になるように、内部循環量を制御する。

図13に内部循環量(循環比)と生成ガス組成の関係を示す。本図は、ガス化室 10 1でのガス滞留時間が十分長いと仮定した場合、あるいは、触媒等によって反応 が平衡組成に近い状態まで進行した場合の計算結果である。

図に示すように、内部高量量(循環比)を減少させるほど、ガス化室1の層温が低下するため、生成ガスもの組成は、H2、COが減り、CO2、H2Oが増える。特に内部循環量(高量比)が少なく、ガス化室1の層温が低い場合は、CH4の量が顕著に増加し、H:、COがこれに対応して大きく減少する。内部循環量(循環比)を変化させることにより、所望の図に示すガス組成を得るよう制御することができる。

図14に内部循環量(循環比)と生成ガスのH2/CO比の関係を示す。本図は、 ガス化室1でのガス滞留時間が十分長いと仮定した場合、あるいは、触媒等によって反応が平衡組成に近い状態まで進行した場合の計算結果である。

図に示すように、生成ガス組成の変化に対応して、内部循環量(循環比)を減少させるほど、 $H_2/CO$ 比が大きくなる。したがって、内部循環量(循環比)の制御により $H_2/CO$ を比2.6から5.7の間の所望の値に制御することが可能である。

25 図15に内部循環量(循環比)と生成ガス発熱量の関係を示す。本図は、ガス化 室1(図1)でのガス滞留時間が十分長いと仮定した場合、あるいは、触媒等によって反応が平衡組成に近い状態まで進行した場合の計算結果である。

図に示すように、全体としては、生成ガス組成の変化に対応して、内部循環量 (循環比)を減少させるほど、CO濃度が低下するため、生成ガス発熱量が減少す

15

る傾向にある。特に、内部循環量(循環比)が少なく、ガス化室1の層温が低い場合は、 $CH_4$ 濃度が増加するため、発熱量が上昇する。内部循環量(循環比)を変えることにより、約10, 600から約10, 900 (HHV D.B.) kJ/m $^3$ -NTPの間で所望の値に制御することができる。

がス化室1でのガス滞留時間が短く、ガス組成が平衡組成と異なる場合には、 以下のような現象となる。

ガス化炉101(図1)のガス性状の第1の制御について説明する。図16は、ガス化原料 a をバイオマスとしたときの、ガス化室層温(単位℃)とガス化室(GC)出口ガス熱量割合(タールを発熱量にカウントする)(単位%)の関係を示す。ガス化室層温が低温の場合は、顕熱ロスが少ないので、ガス化室出口ガス発熱量は高くなり、ガス化室層温が高温の場合は、顕熱ロスが多いので、ガス化室出口ガス発熱量が高温の場合は、顕熱ロスが多いので、ガス化室出口ガス発熱量は高くなり、ガス化室層温が高温の場合は、顕熱ロスが多いので、ガス化室出口ガス発熱量は低くなる。ガス化室層温と循環量に依存関係があることから、循環

量を小さくすることによってガス化室出口ガス発熱量を高くすることができる。 ガス化室出口熱量割合とは、ガス化室出口における単位重量のガス化原料から発 生するガス (タールを含む) の発熱量を、単位重量のガス化原料の燃焼による発 熱量で割ったパーセントをいう。

図17に、ガス化原料 a をバイオマスとしたときの、ガス化室層温(単位℃)と冷ガス効率(単位%)(ガス化室出口のタールを除く可燃ガス発熱量を基に求める)の関係を示す。ガス化室層温が低温の場合は、タール発生が多くなるので、冷ガス効率が下がり、ガス化室層温が高温の場合は、タール発生が少なくなるので、冷ガス効率が上がる。冷ガス効率とは、ガス化室出口における単位重量のガス化原料から発生するガス(タールを含まず)の発熱量を、単位重量のガス化原料の燃焼による発熱量で割ったパーセントをいう。

図18に、ガス化原料 a をバイオマスとしたときの、内部循環量(循環比)とガ 5 ス化室出口の生成ガス発熱量 (タールを除く) (HHV D.B) (単位 K J / m³ - N P T) の関係を示す。内部循環量(循環比)が小さいとガス化室層温が低温に なり、タール発生が多くなるので、発熱量が下がり、内部循環量(循環比)が大き いとガス化室層温が高温になり、タール発生が少なくなるので、発熱量が上がる。

図19に、ガス化原料aをバイオマスとしたときの、ガス化室層温(単位℃)

と、原料 a 中の炭素 (C) がタールに移行した割合(単位%)との関係を示す。 図は、ガス化室層温が低いほど、タール発生量が多いことを示し、ガス化室層温 が高いほど、タール発生量が少ないことを示す。

したがって、バイオマスのようなタール発生量が多く、発熱量の低い原料 a において、冷ガス効率を高くするためには、(1)ガス化室層温を低温として顕熱ロスを低くして、かつ、その際に発生したタールを分解(低分子化)するか、(2)循環量を増加して、ガス化室層温を高くしてタール発生量を抑える方法がある。次に、ガス化炉101(図1)のガス性状の第2の制御について説明する。

循環量を制御することにより、ガス化原料 a の揮発分放出量を制御し、原料 a 中の炭素の、チャー燃焼室 2 へ移動させる量をコントロールすることができる。

図20に、ガス化原料 a をバイオマスとしたときの、循環量(単位 kg/h)と、ガス化室1に供給された原料 a 中の炭素のチャー燃焼室2への移行割合(単位%)との関係を示す。図は、循環量が大きくなると、揮発分として未放出状態の炭素がチャー燃焼室2へ移行する割合が大きくなり、循環量が小さくなると、揮発分として未放出状態の炭素がチャー燃焼室2へ移行する割合が小さくなることを示している。

図21に、ガス化原料 a をバイオマスとしたときの、ガス化室層温(単位℃)と、ガス化室1に供給されたガス化原料 a 中の炭素のチャー燃焼室 2 へ移行する割合(単位%)との関係を示す。層温が高い場合は、揮発分放出量が多く(揮発量残存量が少ない)、かつ、揮発分放出速度も速いので、原料 a 中の炭素がチャー燃焼室 2 へ移行する割合は小さくなると考えられるが、図ではその逆の現象となっている。すなわち、ガス化室層温が高い場合は、原料 a 中の炭素がチャー燃焼室 2 へ移行する割合は大きくなり、ガス化室層温が低い場合は、原料 a 中の炭素がチャー燃焼室 2 へ移行する割合は、小さくなる。これは、ガス化室層温が高いということは、すなわち、循環量が大きいことを意味するので、流動媒体に同伴して、揮発分未放出のガス化原料 a (ここではバイオマス)がチャー燃焼室 2 へ移行することが支配的であることが示されている。

以上のことから、循環量を制御することによって、チャー燃焼室2での燃焼量をコントロールすることが可能であるため、ガス化原料aの変動に応じて、チャ

10

20

-燃焼室2での燃焼量を最適にコントロールすることができる。

なお、図示の実施の形態はあくまでも例示であり、本発明の技術的範囲を限定 する趣旨の記述ではない。

#### 5 産業上の利用可能性

本発明に係るガス化炉は、ガス化室と、チャー燃焼室と、制御装置とを備えるので、弱い流動化状態の流動の強弱を調節することにより、ガス化室とチャー燃焼室の間で流通する流動媒体の量を制御して、ガス化室より発生するガスの組成を制御することができる。

5

10

15

#### 請求の範囲

- 1. 高温の流動媒体を内部で流動させ、第1の界面を有するガス化室流動床を形成し、前記ガス化室流動床内で被処理物をガス化するガス化室と;
- 高温の流動媒体を内部で流動させ、第2の界面を有するチャー燃焼室流動床を 形成し、前記ガス化室でのガス化に伴い発生するチャーを前記チャー燃焼室流動 床内で燃焼させ前記流動媒体を加熱するチャー燃焼室とを備え;

前記ガス化室と前記チャー燃焼室とは、前記それぞれの流動床の界面より鉛直 方向上方においてはガスの流通がないように仕切壁により仕切られ、前記仕切壁 の下部には前記ガス化室と前記チャー燃焼室とを連通する連通口であって、該連 通口の上端の高さは前記第1の界面および第2の界面以下である連通口が形成され、該連通口を挟む前記ガス化室と前記チャー燃焼室のうち一方の室の前記連通 口近傍における前記流動媒体の流動化状態が、他方の室の前記連通口近傍におけ る前記流動媒体の流動化状態よりも強く、該連通口を通じて、前記弱い流動化状 短の方から強い流動化状態の方に流動媒体が移動するように構成され;

さらに、前記弱い流動化状態の流動の強弱を調節することにより、前記ガス化 室と前記チャー燃焼室との間で流通する流動媒体の量を制御して、前記ガス化室 又は前記チャー燃焼室の温度を制御する制御装置を備える;

ガス化炉。

20 2. 被処理物を高温の流動媒体で熱分解してガスとチャーを生成するガス化 室と;

前記ガス化室で生成したチャーを燃焼して前記流動媒体を加熱するチャー燃焼 室とを備え:

前記流動媒体は前記ガス化室と前記チャー燃焼室との間で循環するように構成 25 され;

さらに、前記流動媒体の循環量を調節することにより、前記ガス化室で発生するガスの組成を制御する制御装置を備える;

ガス化炉。

3. 高温の流動媒体を内部で流動させ、第1の界面を有するガス化室流動床

を形成し、前記ガス化室流動床内で被処理物をガス化するガス化室と;

高温の流動媒体を内部で流動させ、第2の界面を有するチャー燃焼室流動床を 形成し、前記ガス化室でのガス化に伴い発生するチャーを前記チャー燃焼室流動 床内で燃焼させ前記流動媒体を加熱するチャー燃焼室とを備え;

5 前記ガス化室と前記チャー燃焼室とは、前記それぞれの流動床の界面より鉛直 方向上方においてはガスの流通がないように仕切壁により仕切られ、前記仕切壁 の下部には前記ガス化室と前記チャー燃焼室とを連通する連通口であって、該連 通口の上端の高さは前記第1の界面および第2の界面以下である連通口が形成され、該連通口を挟む前記ガス化室と前記チャー燃焼室のうち一方の室の前記連通 10 口近傍における前記流動媒体の流動化状態が、他方の室の前記連通口近傍におけ る前記流動媒体の流動化状態よりも強く、該連通口を通じて、前記弱い流動化状態の方から強い流動化状態の方に流動媒体が移動するように構成され;

さらに、前記弱い流動化状態の流動の強弱を調節することにより、前記ガス化室と前記チャー燃焼室の間で流通する流動媒体の量を制御して、前記ガス化により発生するガスの組成を制御する制御装置を備える;

ガス化炉。

15

- 4. 前記チャー燃焼室から流動媒体を導入する熱回収室であって、前記チャー燃焼室からの流動媒体から熱を回収する熱回収装置を有する熱回収室と;
- 該熱回収室内の流動の強弱を調節することにより、前記熱回収装置における熱 20 回収量を制御する制御装置を備える;

請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載のガス化炉。

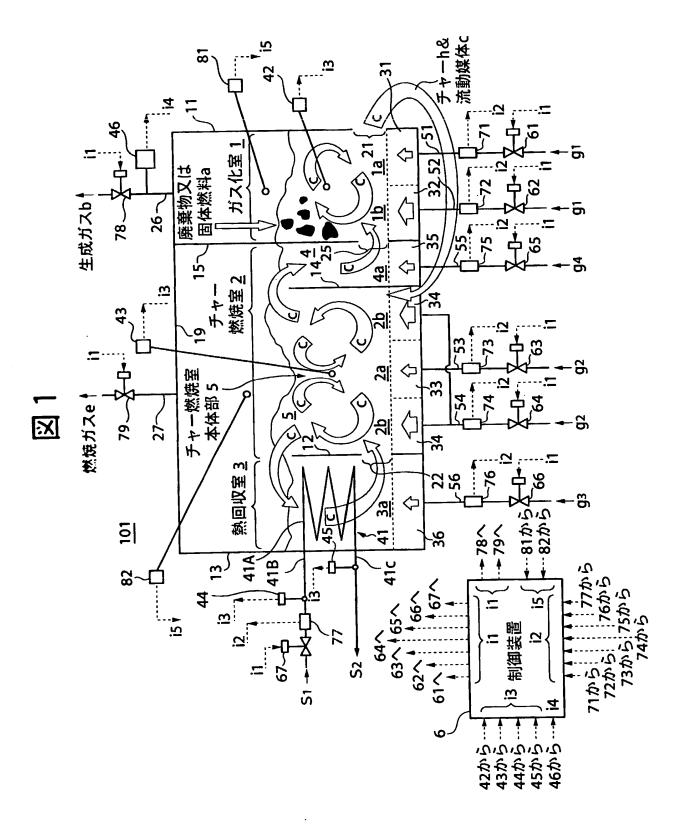
5. 前記熱回収量を制御する制御装置が、前記熱回収装置における熱回収量を制御し、前記チャー燃焼室の温度を制御する;

請求項4に記載のガス化炉。

25 6. 前記ガス化室の第1の界面より上部の第1の圧力と、前記チャー燃焼室の 第2の界面より上部の第2の圧力とを測定する圧力測定装置と;

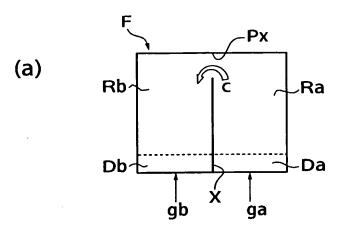
前記ガス化室から発生するガスの、前記ガス化室から排出する第1の排出線速度と、および前記チャー燃焼室から発生する燃焼ガスの、前記チャー燃焼室から 排出する第2の排出線速度とを調節する調節装置と; 前記第1の圧力と前記第2の圧力との圧力差を所定の値とするように前記調節 装置を制御する制御装置とを備える;

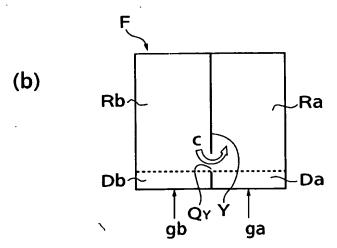
請求項1乃至請求項5のいずれか1項に記載のガス化炉。

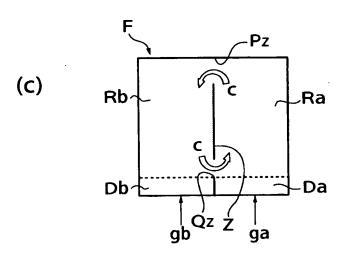


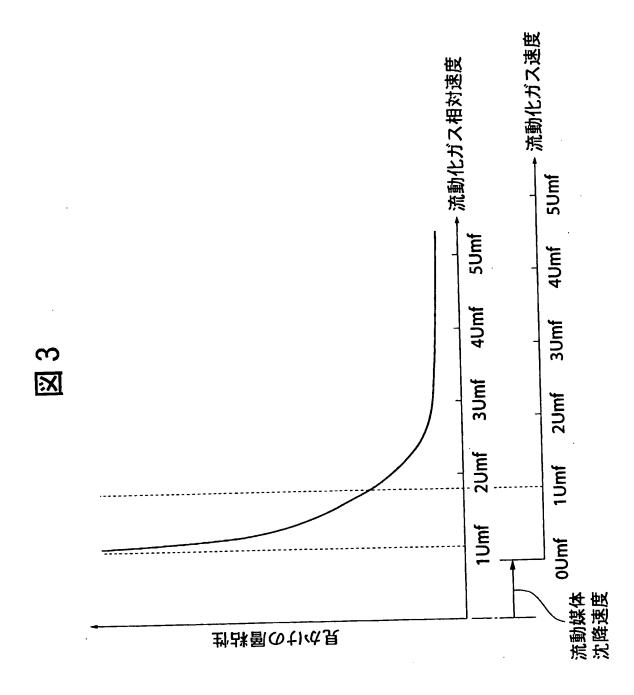
2/22

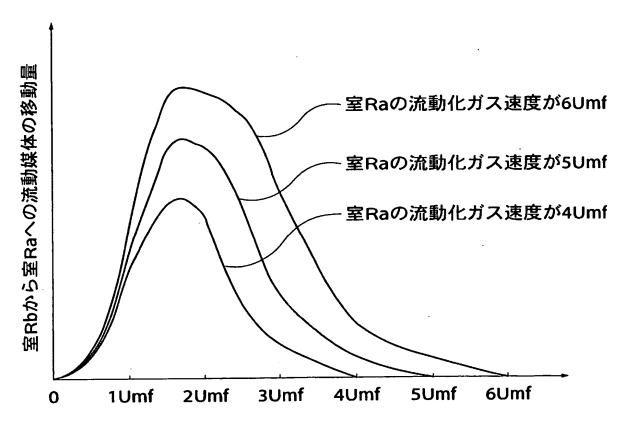




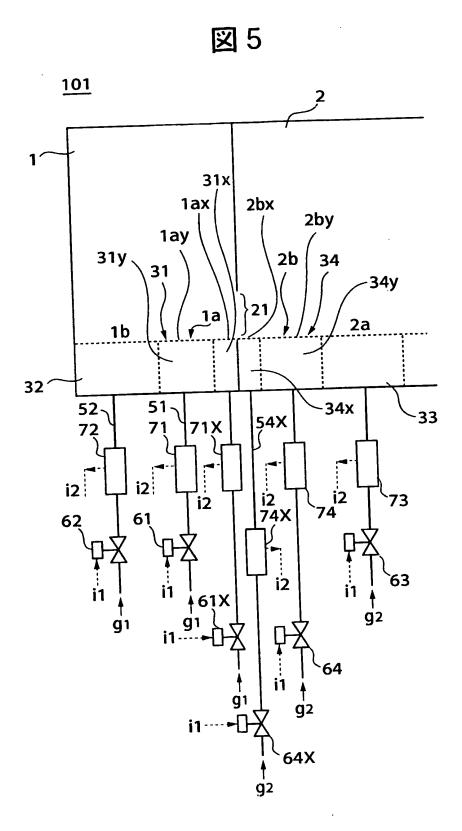


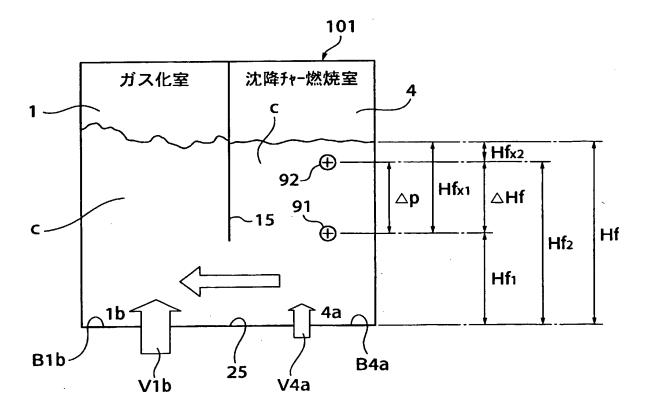


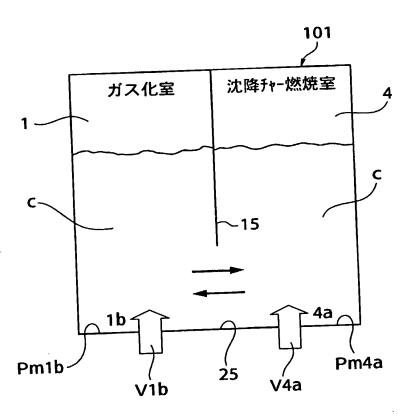


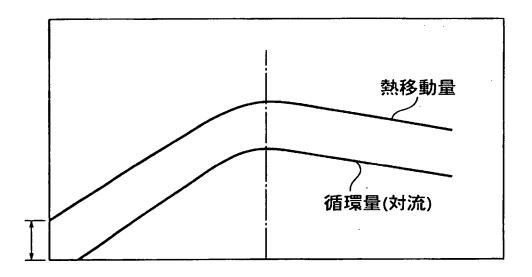


室Rbの流動化ガス相対速度 (流動媒体の沈降速度と流動化ガスとの相対速度)

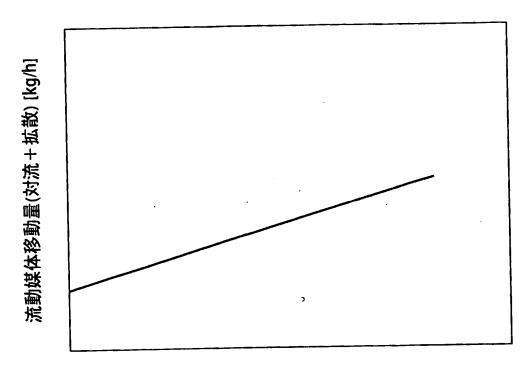






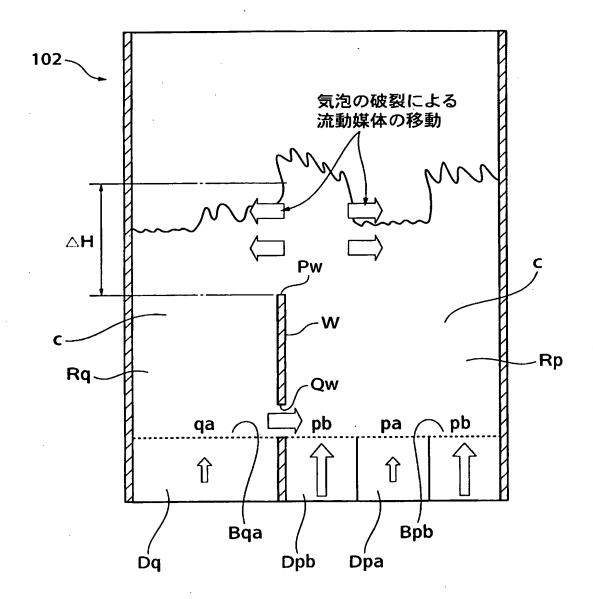


沈降チャー燃焼室空塔速度

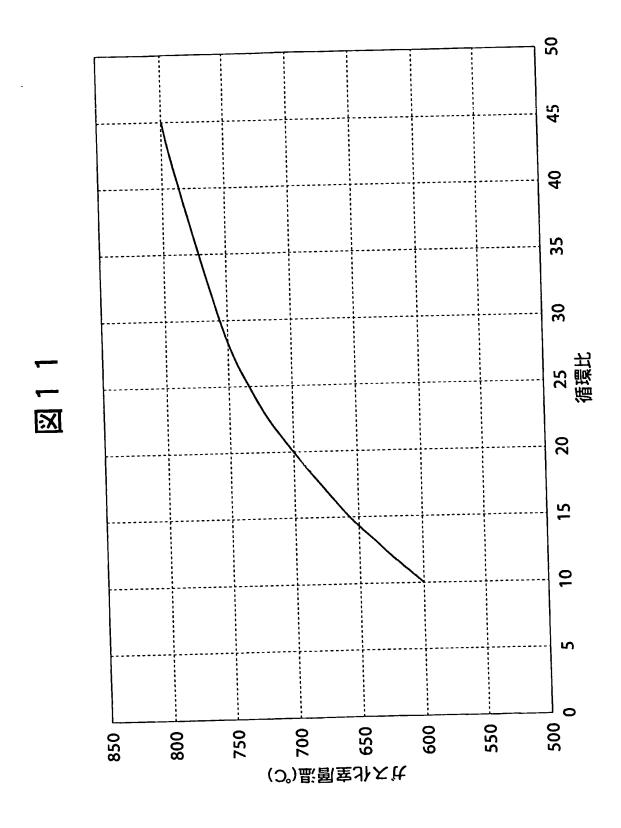


流動チャー燃焼室の流動化ガスのumf比 [-]

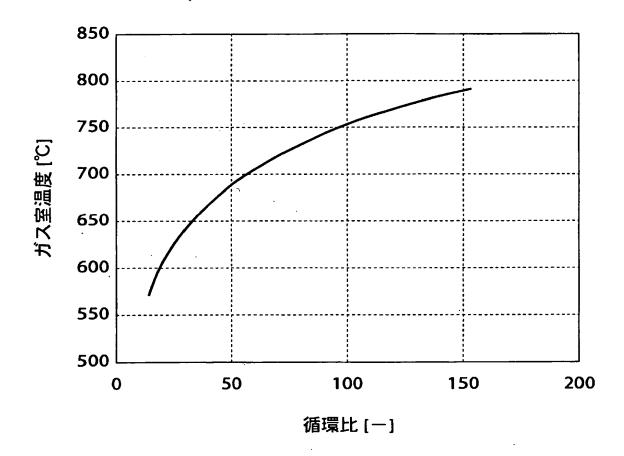
図10



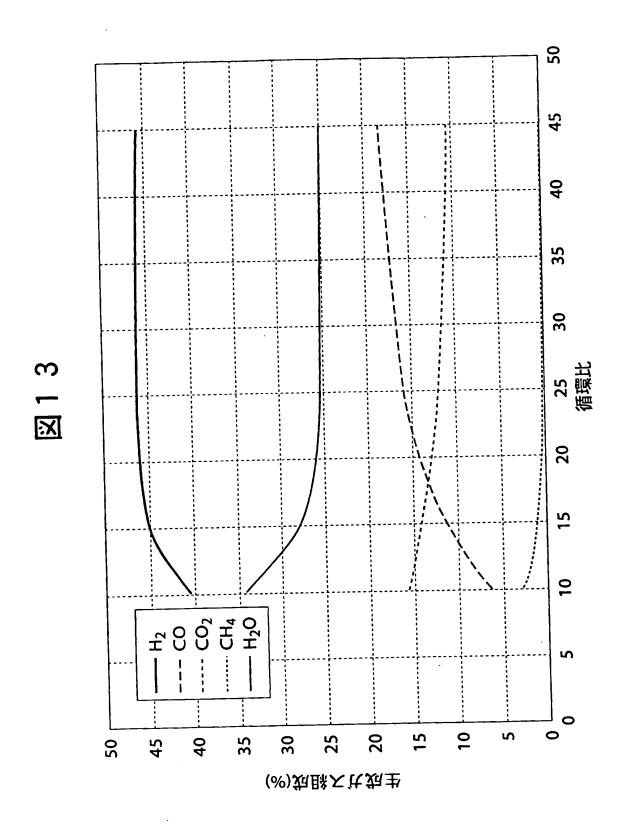
11/22



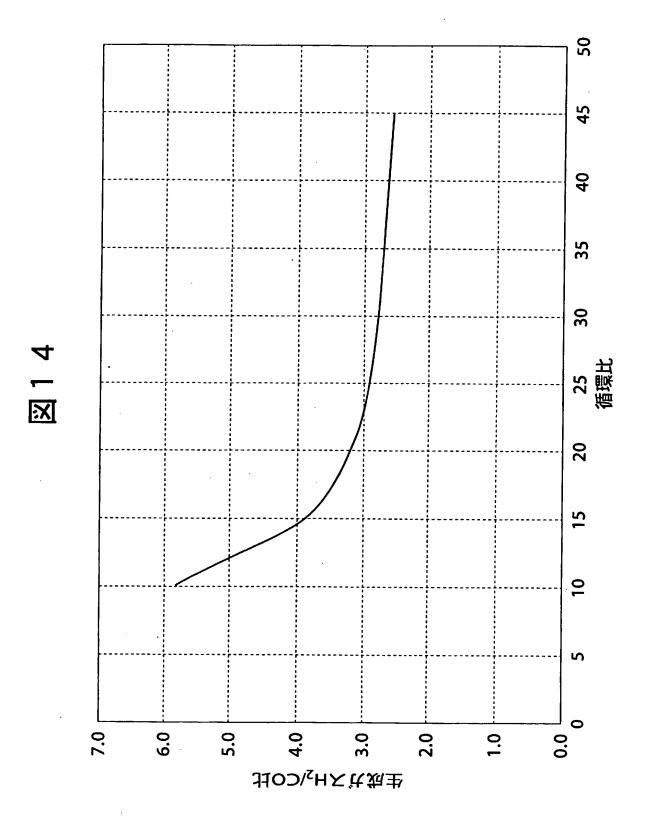
#### 図 1 2







14/22



15/22

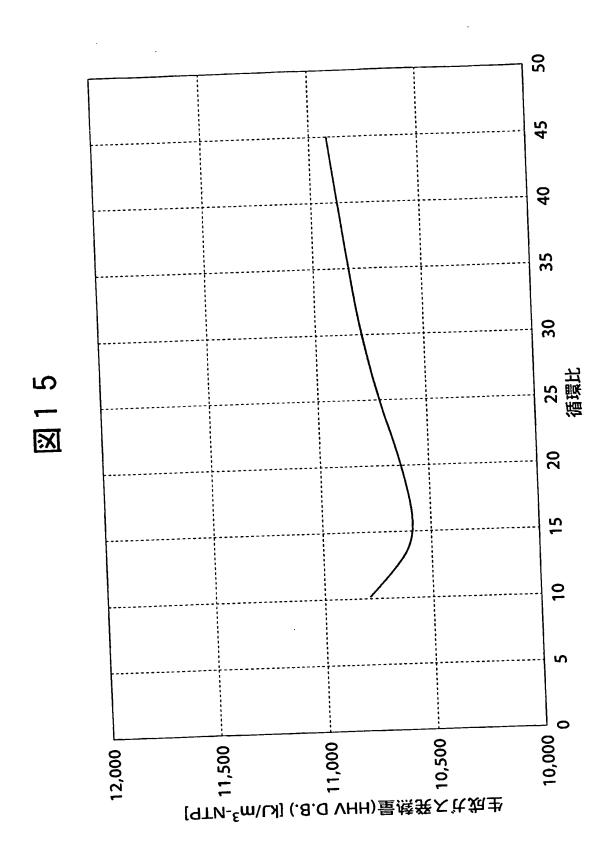
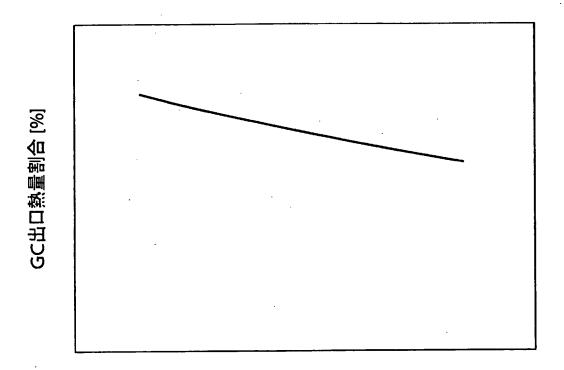
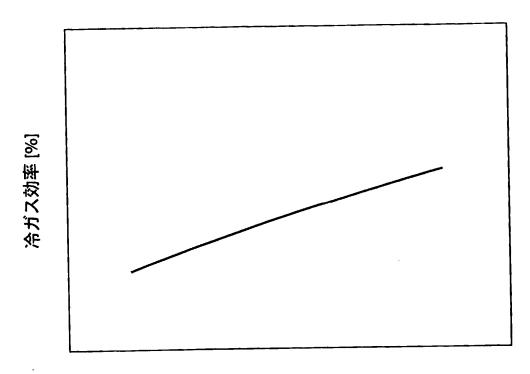


図16

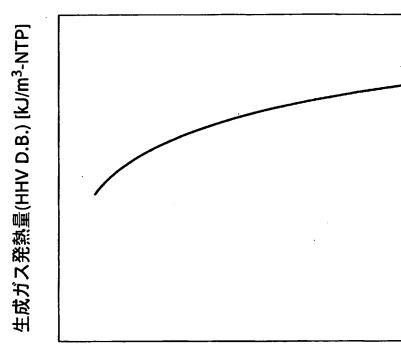


ガス化室層温度 [℃]

図17

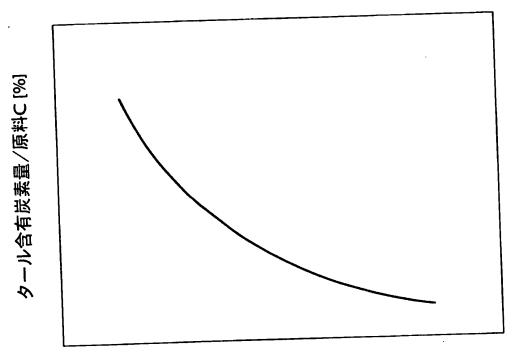


ガス化室層温度 [℃]

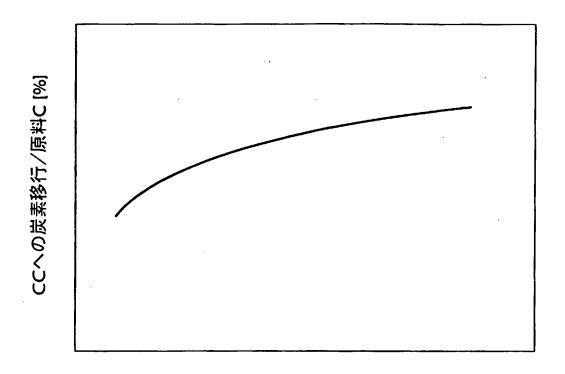


循環比[一]

図19

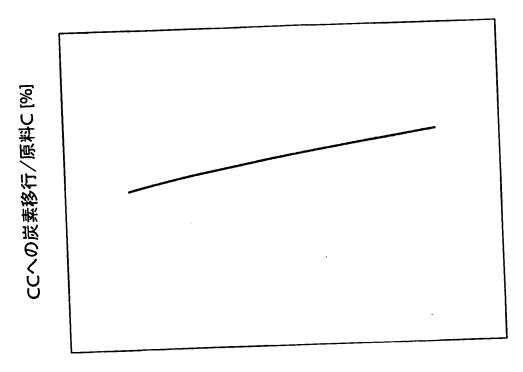


ガス化室層温度 [℃]

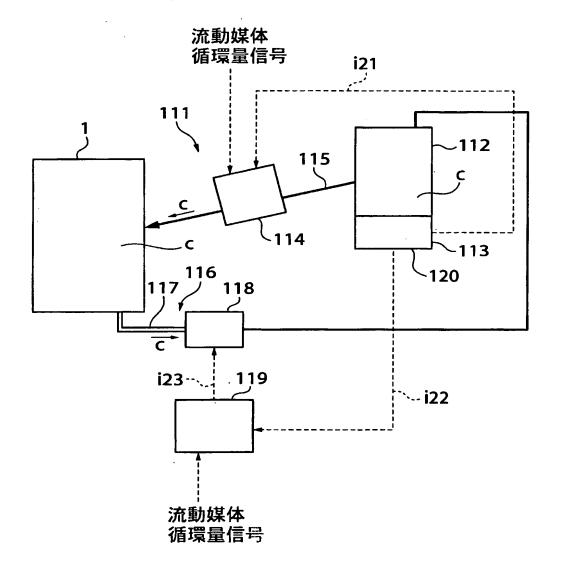


循環量 [kg/h]

図21



ガス化室層温度 [℃]



### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/10267

CL ASSIF	CATION OF SUBJECT MATTER			
Int.Cl	7 C10J3/00			
ording to I	nternational Patent Classification (IPC) or to both national of	classification a	nd IPC	
imum doc	imentation searched (classification system followed by	ssification sym	loois)	
Int.C	1 <sup>7</sup> C10J3/00			
	n searched other than minimum documentation to the exter	nt that such do	cuments are included i	n the fields searched
cumentatio	n scalched onler men			
		tata base and. V	where practicable, sear	ch terms used)
ectronic da	a base consulted during the international search (name of d	Jata Daso uno,	•	
DOCUN	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			Relevant to claim No.
ategory*	Citation of document, with indication, where approp	oriate, of the rel	evant passages	1-6
	WO 99/31 (Ebara Corp.),			. 1-0
X	24 June, 1999 (24.06.99),			
1	Full text & JP 11-181450 A & EP 10	043385 A	1	
	& DE II 10115			
-				
C Foot	ther documents are listed in the continuation of Box C.		nt family annex.	
<u> </u>	s in a de companie	"T" later docu	ment published after the	international filing date or th the application but cited to underlying the invention
"A" doc	ument defining the general state of the art	understan	d the principle of theory	the claimed invention cannot
"E" earl	ier document but published on of after the	considere	d novel or cannot be con	1
date	ument which may throw doubts on priority claim(s) or which is d to establish the publication date of another citation or other	"Y" documen	t of particular relevance;	step when the document is
cite	d to establish the publication date of another examination of other cial reason (as specified) current referring to an oral disclosure, use, exhibition or other		d with one or more other tion being obvious to a p	
		combinat	tion being obvious to a p it member of the same pa	tent family
"O" doo	ans	"&" documen	it member of the same pe	•
"O" doe "P" do	ans cument published prior to the international filing date but later	C-silie	og of the international	search report
"O" doo me "P" do tha	ans cument published prior to the international filing date but later in the priority date claimed	C-silie	ng of the international ctober, 2003	search report
"O" doo me "P" do tha	ans cument published prior to the international filing date but later	Date of mailing 07 O	ng of the international ctober, 2003	search report
"O" doe me "P" doe that Date of 25	ans cument published prior to the international filing date but later in the priority date claimed the actual completion of the international search September, 2003 (25.09.03)	C-silie	ng of the international ctober, 2003	search report
"O" doe me "P" doe that Date of 25	ans cument published prior to the international filing date but later in the priority date claimed	Date of mailing 07 O	ng of the international ctober, 2003	search report

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998)

A. 発明の属する分野の分類(国際作 Int. Cl <sup>7</sup> C10 J3/00	寺許分類 (I P C))			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類 Int. Cl <sup>7</sup> Cl0 J3/00	類(IPC))			
最小限資料以外の資料で調査を行った分	分野に含まれるもの		and Species	
国際調査で使用した電子データベース	(データベースの名称、	調査に使用した用語)		
C. 関連すると認められる文献	***			
引用文献の カテゴリー* 引用文献名 及び-	一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
1	全文 & JP 1	式会社 荏原製作所) 199 11-181450 A &	1-6	
□ C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。				
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 25.09.0	) 3	国際調査報告の発送日 3/.10.0	3	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-891 東京都千代田区霞が関三丁目	5	特許庁審査官 (権限のある職員) 吉住 和之 (		

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1998年7月)

# THIS PAGE LEFT BLANK